การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนแบบหลายชั้น ที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430



# จุฬาสงกรณมหาวทยาลย Chill Al ONGKORN UNIVERSITY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

ELECTRODEPOSITION OF COMPOSITION-MODULATED MULTILAYER NI-W ALLOY COATINGS ON 430 STAINLESS STEEL



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering Department of Metallurgical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2013 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน
	แบบหลายชั้นที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้
	สนิมเกรด 430
โดย	นายณัฐดล อุดมปณิธ
สาขาวิชา	วิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ชาคร จารุพิสิฐธร)

\_\_\_\_อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(อาจารย์ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาชาย เหลืองวรานันท์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร)

ณัฐดล อุดมปณิธ : การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนแบบหลายชั้น ที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430. (ELECTRODEPOSITION OF COMPOSITION-MODULATED MULTILAYER NI-W ALLOY COATINGS ON 430 STAINLESS STEEL) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณี รัตน์, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: อ. ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว, 96 หน้า.

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของโลหะผสม นิกเกิลทังสเตนผลึกนาโน (nanocrystalline Ni-W) ที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีโดยวิธีการ ชุบไฟฟ้า โดยการควบคุมกระแส reverse pulse ในรูปแบบสัญญาณที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า ทำ การชุบเคลือบในระบบอ่างชุบเดี่ยวที่มี nickel sulfate hexahydrate และ sodium tungstate dihydrate เป็นแหล่งของโลหะ ส่วนประกอบทางเคมี ขนาดเกรน ตลอดจนความหนาของชั้น เคลือบย่อยในการชุบไฟฟ้าแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีของโลหะผสมนิกเกิล ทังสเตนสามารถที่จะออกแบบได้ โครงสร้างที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดและอุปกรณ์ วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างแบบหลายชั้นตามที่ได้มีการออกแบบไว้ ผลของ ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยในระดับนาโนแสดงให้ เห็นถึงความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความแข็งผิวที่ได้จากกฎการ ผสมของชั้นเคลือบเดี่ยวที่นำมาสลับ นอกจากนี้การศึกษาการสึกหรอโดยเทคนิค ball-on-disc และโครงสร้างภายหลังการสึกหรอแสดงให้เห็นถึงความต้านทานการสึกหรอและสมประสิทธิ์แรง เสียดทานได้รับอิทธิพลมาจากส่วนประกอบทางเคมีและความหนาของชั้นเคลือบย่อย การลดง ของความหนาชั้นเคลือบเย่อยส่งผลให้ความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรง เสียดทานได้รับอิทธิพลมาจากส่วนประกอบทางเคมีและความหนาของชั้นเคลือบย่อย การลดลง ของความหนาชั้นเคลือบเย่อยองผลให้ความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่า เพิ่มขึ้น

จากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่าชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี ของวัสดุนิกเกิลทังสเตนที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อยในระดับนาโนเมตรสามารถช่วยลดปริมาณ การใช้ธาตุทังสเตนได้ 37 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถคงสมบัติด้านความแข็งและความต้านทาน การสึกหรอ ให้อยู่ในระดับเดียวกับชั้นเคลือบโลหะผสมที่มีปริมาณทังสเตนสูง

# **Chulalongkorn University**

ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อ	นิสิต	
ลายมือชื่อ	อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	
ลายมือชื่อ	อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	

# # 5370234721 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEYWORDS: ELECTRODEPOSITON / NICKEL TUNGSTEN / MULTILAYER / HARDNESS / WEAR RESISTANCE

NATTADON UDOMPANIT: ELECTRODEPOSITION OF COMPOSITION-MODULATED MULTILAYER NI-W ALLOY COATINGS ON 430 STAINLESS STEEL. ADVISOR: ASST. PROF. YUTTANANT BOONYONGMANEERAT, Ph.D., CO-ADVISOR: PANYAWAT WANGYAO, Ph.D., 96 pp.

The present studies investigate the mechanical properties of composition-modulated multilayer coating (CMMC) of Ni-W as fabricated by electrodeposition. By regulating the pulse waveforms of the applied pre-define current profiles , using a single electrolytic bath containing nickel sulfate hexahydrate and sodium tungstate dihydrate as metal sources, the chemical composition, grain size, and the individual layer thickness of the electrodeposited Ni-W CMMC can be tailored. The scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy analysis reveal that multilayer coatings are obtained as designed. The micro-hardness assessment shows important evidence in that the Ni-W CMMC with nanometer-thick layer exhibits improvement of hardness by 31% over those of the rule of mixture of homogenous Ni-W alloy counterparts. Furthermore, the ball-on-disc test and the subsequent microstructural analysis indicates that the wear resistance and friction coefficient of Ni-W CMMC are influenced by the composition and the thickness of the individual alternating layer. The decrement of interlayer's size monotoically increase wear resistance and friction coefficient.

From this work, it has been found that the Ni-W CMMC with nanometerthick layer can reduce the amount of elemental tungsten as much as 37% and maintain hardness and wear resistance as comparable with high tungsten alloys.

Department:	Metallurgical Engineering	Student's Signature
Field of Study:	Metallurgical Engineering	Advisor's Signature
Academic Year:	2013	Co-Advisor's Signature

#### กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์จาก บุคคลสำคัญหลายท่าน โดยข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ให้ความรู้และทักษะที่มีประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร ที่ให้ข้อคิดที่ดีและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย นอกจากนี้ยังขอขอบพระคุณ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการชุบเคลือบผิวโลหะ (PORETEGE research group) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ ที่เป็นสถานที่ในการทำการวิจัยและให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและ สารเคมีในการทำงานวิจัย ขอขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และคุณศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ ที่ช่วยอนุเคราะห์ในการทำการวิจัย ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนในการทำการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สาหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA, University Industry Research Collaboration; NUI-RC) สัญญารับทุนเลขที่ NUI-RC-01-55-009 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมโลหการที่สอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเติบโตอย่าง อดทนและแข็งแกร่ง ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ สำหรับความช่วยเหลือและกำลังใจที่ดีในการต่อสู้กับ อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา และที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้ตลอดมาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา



# สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญช
สารบัญตารางฏ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนำ1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 นิกเกิล
2.1.2 ทั้งสเตน
2.1.3. การเคลือบผิววัสดุ (suface coating)5
2.1.4 การชุบเคลือบผิวโลหะโดยวิธีการแบบใช้ไฟฟ้า7
2.1.4.1 โลหะที่นิยมนำมาชุบไฟฟ้า10
2.1.4.1.1 โครเมียม
2.1.4.1.2 นิกเกิล
2.1.4.2 กฎฟาราเดย์
2.1.4.3 ชั้ว
2.1.4.4 พีเอช (pH)
2.1.4.5 ความหนาแน่นของกระแส (current density)
2.1.4.6 กระแสแบบ pulse12
2.1.5 การชุบนิกเกิลสไตร์ค (Nickel strike)
้ 2.1.5.1 นิกเกิลสไตร์ค ชนิดคลอไรด์14

2.1.5.2 นิกเกิลสไตร์ค ชนิดซัลเฟต	14
2.1.6 สมบัติเชิงกลที่สำคัญของการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้า	15
2.1.6.1 ความแข็งผิว	15
2.1.6.2 การสึกหรอ	16
2.1.6.2.1 การสึกหรอแบบขัดสี (abrasion)	17
2.1.6.2.2 การสึกหรอแบบกัดเซาะ (erosion)	18
2.1.6.2.3 การสึกหรอแบบเกาะติด (adhesion)	19
2.1.6.2.4 การสึกหรอโดยกลไกการล้า (surface fatigue)	19
2.1.7 ชั้นเคลือบแบบหลายชั้น (multilayer)	20
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	22
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	39
3.1 เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานวิจัย	39
3.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมผิวชิ้นงาน	39
3.1.2  อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้สำหรับการชุบเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้า ได้แก่ .	39
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและทดสอบวัสดุ	39
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย	40
3.2.1 การเตรียมผิวเห <sub>ล็กกล้</sub> าไร้สนิมเกรด 430	40
3.2.2 การชุบเคลือบผิวด้วยนิกเกิลสไตร์ค	41
3.2.3 การชุบเคลือบผิวโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนแบบใช้ไฟฟ้ากระแส reverse pulse	41
3.2.3.1 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของจำนวนชั้นเคลือบที่แตกต่ โดยมีความหนารวมคงที่	างกัน 43
3.2.3.2 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของความหนารวมของชั้นเคลื ที่แตกต่างกัน	iอบ 43
3.2.3.3 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของการสลับชั้นที่มีส่วนประก ทางเคมีที่แตกต่างกัน	เอบ 44
3.3 การตรวจสอบชั้นเคลือบ	45
3.3.1 การตรวจสอบและพิสูจน์โครงสร้างจุลภาค	45
3.3.3 การตรวจสอบความแข็งผิว	45

3.3.3 การตรวจสอบความต้านทานการสึกหรอ	45
บทที่ 4 ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง	46
4.1 การเตรียมผิวชิ้นงานและการชุบนิกเกิลสไตร์ค	46
4.2 การชุบไฟฟ้าโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน	46
4.2.1 การใช้กระแส reverse pulse ในการชุบไฟฟ้า	46
4.2.2 ขนาดเกรน XRD	50
4.2.3 โครงสร้างจุลภาคของพื้นผิวชั้นเคลือบนิกเกิลทั้งสเตน	52
4.2.4 ค่าความแข็งผิว	53
4.2.5 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (friction coefficient)	53
4.2.6 ค่าความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบ	55
4.3 การชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี	61
4.3.1 โครงสร้างที่ได้จากการชุบเคลือบแบบหลายชั้น	63
4.3.2 ส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น	66
4.4 ความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น	67
4.5 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น	70
4.6 ความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น	73
4.6.1 ผลของความหนาชั้นเคลือบย่อย	73
4.6.2 ผลของส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบย่อย	76
4.7 ผลของระยะเวลาในการชุบเคลือบและความหนารวมของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลาย	มชั้น
	80
4.8 การเปรียบเทียบปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบเฉลี่ยและค่าความแข็งผิว	86
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	88
รายการอ้างอิง	90
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	96

# สารบัญตาราง

หน้า	
ตารางที่ 2. 1 ลักษณะการชุบเคลือบผิวแบบต่าง ๆ [21]6	
ตารางที่ 2. 2 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสารละลายอิเล็คโตรไลต์ ในการชุบโลหะแบบใช้ไฟฟ้าและ	
คุณสมบัติของชั้นเคลือบ [1]	
ตารางที่ 2. 3 ปริมาณธาตุทังสเตน ขนาดเกรน และสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนที่	
ได้จากการซุบไฟฟ้า [4]	
ตารางที่ 2. 4 สารเคมีและปริมาณที่ใช้ในการเตรียมสารละลายอิเล็คโตรไลต์สำหรับการชุบเคลือบ	
โลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน [10]	
ตารางที่ 2. 5 การจ่ายค่ากระแส reverse pulse ปริมาณธาตุทั้งสเตน และขนาดเกรน ของโลหะผสม	
นิกเกิลทังสเตน [10]27	
ตารางที่ 2. 6 ค่าช่วง reverse pulse ปริมาณส่วนประกอบทางเคมี และขนาดเกรน ของชั้นเคลือบ	
วัสดุโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน [3]	
ตารางที่ 2. 7 ค่าขนาดเกรน และสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน Ni–22%W ที่ผ่านการอบอ่อนเป็นเวลา 30	
นาที [3]	

ตารางที่ 4. 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่ากระแสช่วงสลับ, ปริมาณของธาตุทังสเตนในชั้นเคลือ	)ປ
และขนาดผลึกสัมพัทธ์	47
ตารางที่ 4. 2 ปฏิกิริยารีดักชั่นและค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของโลหะนิกเกิลและทังสเตน[10]	49
ตารางที่ 4. 3 ผลการทดลองความแข็งผิวของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตนประเภทชั้นเคลือบเดี่ยว	53
ตารางที่ 4. 4 ผลปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน	58
ตารางที่ 4. 5 ชิ้นงานการชุบเคลือบนิกเกิลทังสเตนแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี	
และตัวแปรต่าง ๆ	62
ตารางที่ 4. 6 ผลการทดลองค่าความแข็งผิวของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของนิกเกิล	
ทั้งสเตน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความแข็งผิว	69
ตารางที่ 4. 7 ค่าความแข็งผิวที่ได้จากกฎการผสม เปรียบเทียบกับค่าความแข็งผิวของโครงสร้างแบ	ບ
หลายชั้นที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อย 50 นาโนเมตร	70

ตารางที่ 4. 8 ผลของปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น AC-xx	ที่ความหนาชั้น
เคลือบย่อยต่าง ๆ	75
ตารางที่ 4. 9 ผลของปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของชิ้นงาน A	\B-50, AC-50
และ AD-50	78
ตารางที่ 4. 10 ผลของการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของชิ้นงาน AC-50 โดยใช้ระยะ	เวลาต่างกัน 86
ตารางที่ 4. 11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณทั้งสเตนของชั้นเคลือบและค่าสมบัติกล	



# สารบัญภาพ

ภาพที่ 2. 1 ช่วงการเคลือบโดยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน	6
ภาพที่ 2. 2 ตัวอย่างการเคลือบด้วยวิธีการชุบไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ [1]	7
ภาพที่ 2. 3 ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบที่ได้จากการชุบไฟฟ้าของโลหะและโลหะผสม [1]	8
ภาพที่ 2. 4 ภาพจำลองอ่างชุบเคลือบโลหะแบบใช้ไฟฟ้า	9
ภาพที่ 2. 5 รูปแบบการชุบเคลือบแบบ pulse [23]	13
ภาพที่ 2. 6 รูปแบบการชุบเคลือบแบบ reverse pulse [23]	13
ภาพที่ 2. 7 ความสัมพันธ์ของ Hall-Petch ของชั้นเคลือบโลหะชนิดต่าง ๆ [25]	15
ภาพที่ 2. 8 ค่าความแข็งผิวที่สัมพันธ์กับขนาดเกรนของชั้นเคลือบนิกเกิล [25]	16
ภาพที่ 2. 9 แผนภาพแสดงการสึกหรอในลักษณะต่าง ๆ [25]	17
ภาพที่ 2. 10 กลไกการสึกหรอแบบขัดสี [26]	18
ภาพที่ 2. 11 ลักษณะการสึกหรอแบบกัดเซาะ [26]	18
ภาพที่ 2. 12 กลไกการสึกหรอแบบเกาะติด [26]	19
ภาพที่ 2. 13 กลไกการสึกหรอที่เกิดจากการล้า [26]	20
ภาพที่ 2. 14 ปริมาตรการสึกหรอต่อหน่วยเวลาของผิวเคลือบวัสดุชนิดต่าง ๆ [25]	20
ภาพที่ 2. 15 ค่าความแข็งพื้นผิวของชั้นเคลือบวัสดุนิกเกิลและโคบอลต์แบบหลายชั้นที่ความหนา	ชั้น
เคลือบต่างกัน [27]	21
ภาพที่ 2. 16 ปริมาตรการสึกหรอต่อหน่วยระยะไถลของชั้นเคลือบวัสดุคอมโพสิทนิกเกิลทองแดง	
โลหะนิกเกิล และโลหะทองแดง [25]	22
ภาพที่ 2. 17 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากเทคนิค SEM ของชั้นเคลือบโลหะเนื้อพื้นนิกเกิลและอนุภ	าค
ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ผลิตโดยวิธีชุบไฟฟ้าที่ความหนาแน่นกระแส ก) 2 A•dm <sup>-2</sup> , ข) 3 A• dm <sup>-2</sup> , ค) 4	1
A•dm <sup>-2</sup> [28]	23
ภาพที่ 2. 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวและความหนาแน่นกระแสที่ใช้ในวั	<u>ଶ</u> ଜୁ
นิกเกิล และนิกเกิลที่มีการเติมอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ [28]	24
ภาพที่ 2. 19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและค่าความแข็งผิวของวัสต	Ĵ
โลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน [4]	25
ภาพที่ 2. 20 กราฟแสดงผลของค่าความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการทดสอบการสึกหรอ [4]	26
ภาพที่ 2. 21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสย้อนกลับ, ปริมาณทั้งสเตน	
และขนาดเกรน ของวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน [10]	27
1	

ภาพที่ 2. 22 กราฟแสดงการเปรียบเทียบของค่าความแข็งผิวของชิ้นงาน Ni-22W ที่ผ่านการอบอ่อน
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในบริเวณที่ไม่มีการสึกหรอ และบริเวณรอยการสึกหรอ [3]
ภาพที่ 2. 23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและแรงกดของชั้นเคลือบหลายชั้นที่มี
จำนวนชั้นแตกต่างกัน [18]
ภาพที่ 2. 24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและแรงกดของชั้นเคลือบหลายชั้นที่มี
จำนวนชั้นแตกต่างกัน [18]
ภาพที่ 2. 25 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากเทคนิค TEM มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ของชั้นเคลือบอสัณฐาน Ni-
P-W [17]
ภาพที่ 2. 26 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งพื้นผิวกับอุณหภูมิการอบอ่อนของวัสดุที่ผ่านการชุบ
เคลือบแบบหลายชั้น [17]
ภาพที่ 2. 27 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอดูลัสและความหนาของชั้นเคลือบย่อยที่อยู่ติดกันของวัสดุ
Ni-P-W [15]
ภาพที่ 2. 28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งพื้นผิวและค่าความหนาของชั้นเคลือบย่อยที่อยู่ติดกัน
ของวัสดุ Ni-P-W [15]
ภาพที่ 2. 29 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและความลึกรอยกด ที่สัดส่วน
ความหนาของชั้นเคลือบนิกเกิลมากกว่าทองแดง [19]
ภาพที่ 2. 30 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและความลึกรอยกด ที่สัดส่วน
ความหนาของชั้นเคลือบทองแดงมากกว่านิกเกิล [19]
ภาพที่ 2. 31 ความสัมพันธ์ของความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและความลึกรอยกด ที่ความหนาชั้น
เคลือบย่อยต่าง ๆ [19]
ภาพที่ 2. 32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งผิวและความหนาของชั้นเคลือบย่อยในชั้น
เคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุในระบบต่าง ๆ [29]
ภาพที่ 2. 33 แบบจำลองแสดงกระบวนการย่อยในการหากลไกที่ได้รับในวัสดุโลหะโครงสร้างหลาย ชั้น

ภาพที่ 3. 1 รูปแบบการชุบเคลือบแบบช่วงสลับ โดยมีการปรับค่ากระแสช่วงกลับเพื่อให้ได้	
ส่วนประกอบทางเคมีต่าง ๆ	42
ภาพที่ 3. 2 แบบจำลองลักษณะการสลับรูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า A สลับ C	42
ภาพที่ 3. 3 การจำลองชั้นเคลือบที่มีความหนารวมเท่ากันแต่มีจำนวนชั้นเคลือบแตกต่างกัน	43
ภาพที่ 3. 4 ภาพจำลองชั้นเคลือบที่มีความหนารวมแตกต่างกัน แต่มีความหนาแต่ละชั้นเคลือบ	
เท่ากัน	44

ภาพที่ 4. 1 ลักษณะพื้นผิวของขิ้นงานภายหลังการชุบเคลือบโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนผลึกนาโนลง
บนผิวชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม
ภาพที่ 4. 2 โครงสร้างภาคตัดขวางของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตนที่ได้จากการชุบไฟฟ้ากระแส reverse
pulse ก) ชิ้นงาน A (Ni-6.3W) ข) ชิ้นงาน C (Ni-13.8W)48
ภาพที่ 4. 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส reverse pulse และปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบ
ของวัสดุผสมนิกเกิลทั้งสเตนผลึกนาโน
ภาพที่ 4. 4 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทังสเตน ชิ้นงาน A, B, C และ D
ภาพที่ 4. 5 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคพื้นผิวของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตนผลึกนาโน ก) ชิ้นงาน A ข)
ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D
ภาพที่ 4. 6 กราฟแสดงผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ได้จากการทดสอบการ สึก
หรอ ของชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยวนิกเกิลทังสเตน54
ภาพที่ 4. 7 กราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยของชิ้นงานกลุ่มชั้นเคลือบเดี่ยวนิกเกิล
ทั้งสเตน
ภาพที่ 4. 8 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ A (Ni-6.3W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ56
ภาพที่ 4. 9 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ B (Ni-8.7W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ56
ภาพที่ 4. 10 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ C (Ni-13.8W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ57
ภาพที่ 4. 11 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ D (Ni-29.4W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ57
ภาพที่ 4. 12 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย 500 เท่า ก) ชิ้นงาน A ข)
ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D
ภาพที่ 4. 13 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย 3000 เท่า ก) ชิ้นงาน A ข)
ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D
ภาพที่ 4. 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนกลับของค่าความแข็งผิวและปริมาตรการสึก
หรอ ของชิ้นงานชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน60
ภาพที่ 4. 15 โครงสร้างจุลภาคของภาคตัดขวางที่ได้จากการชุบชิ้นงานแบบหลายชั้น ก) ชิ้นงาน AC-
5000, ข) ชิ้นงาน AC-500, ค) ชิ้นงาน AC-50
ภาพที่ 4. 16 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแต่ละชนิดที่ได้จากเทคนิค EPMA ของชิ้นงาน
AC-5000
ภาพที่ 4. 17 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแต่ละชนิดที่ได้จากเทคนิค EPMA แบบรวม ของ
ชิ้นงาน AC-5000

ภาพที่ 4. 18 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุนิกเกิล ที่ได้จากเทคนิค EPMA ของชิ้นงาน AC-
5000
ภาพที่ 4. 19 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุทังสเตน ที่ได้จากเทคนิค EPMA ของชิ้นงาน
AC-5000
ภาพที่ 4. 20 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุนิกเกิล ทั้งสเตน และนิกเกิลทั้งสเตน ที่ได้จาก
เทคนิค EPMA ของชิ้นงาน AC-500065
ภาพที่ 4. 21 ภาพลักษณะการหาส่วนประกอบทางเคมีในโครงสร้างจุลภาคของภาคตัดขวางชิ้นงาน
ชั้นเคลือบแบบหลายชั้น AC-5000 โดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสดงตำแหน่งชั้นเคลือบย่อย C และ
เครื่องหมายบวกแสดงตำแหน่งชั้นเคลือบย่อย A
ภาพที่ 4. 22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบย่อย และค่าความแข็งผิว ของ
ชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น67
ภาพที่ 4. 23 ผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ได้จากระหว่างการทดสอบการสึกหรอ ของ
ชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นในระบบการชุบเคลือบแบบสลับต่าง ๆ
ภาพที่ 4. 24 กราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ย ของชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นใน
ระบบการชุบเคลือบแบบสลับต่าง ๆ71
ภาพที่ 4. 25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยและค่าความหนาของ
ชั้นเคลือบย่อย ในชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นระบบ AC-xx72
ภาพที่ 4. 26 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-5000 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ73
ภาพที่ 4. 27 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-500 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ74
ภาพที่ 4. 28 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ74
ภาพที่ 4. 29 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-25 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ75
ภาพที่ 4. 30 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AB-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ76
ภาพที่ 4. 31 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ77
ภาพที่ 4. 32 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AD-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ77
ภาพที่ 4. 33 ลักษณะภาคตัดขวางของร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นในชิ้นงาน AB-50,
AC-50 และ AD-50
ภาพที่ 4. 34 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย ก <b>)</b> และ ข) ชิ้นงาน AB-50, ค) และ
ง) ชิ้นงาน AC-50, จ) และ ฉ) ชิ้นงาน AD-50 ที่กำลังขยาย 500 และ 3000 เท่า ตามลำดับ
ภาพที่ 4. 35 ภาพแสดงโครงสร้างของภาคตัดขวางและความหนารวมของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นใน
ระบบชิ้นงาน AC-xx โดยในการชุบเคลือบรวมที่ระยะเวลา ก) 15 นาที, ข) 30 นาที, ค) 60 นาที และ
ง) 90 นาที81

ภาพที่ 4. 36 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการชุบเคลือบ และความหนารวมของชั้นเคลือบแบบ
หลายชั้น ในชิ้นงาน <b>AC</b> -50
ภาพที่ 4. 37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิว และระยะเวลาในการชุบเคลือบ ของ
ชิ้นงาน <b>AC-50</b>
ภาพที่ 4. 38 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 15 นาที ก)
แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ84
ภาพที่ 4. 39 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 30 นาที ก)
แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ84
ภาพที่ <b>4</b> . 40 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน <b>AC-50</b> ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 60 นาที ก)
แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ85
ภาพที่ 4. 41 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 90 นาที ก)
แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

ภาพที่	ผ. :	l X-ray	diffraction	ของวัสดุนิกเกิลทั้งสเตน	ชิ้นงาน	Α	94
ภาพที่	ผ. 2	2 X-ray	diffraction	ของวัสดุนิกเกิลทั้งสเตน	ชิ้นงาน	В	94
ภาพที่	ผ. 3	3 X-ray	diffraction	ของวัสดุนิกเกิลทั้งสเตน	ชิ้นงาน	С	95
ภาพที่	Ю. 4	1 X-ray	diffraction	ของวัสดุนิกเกิลทั้งสเตน	ชิ้นงาน	D	95

# จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

## บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การปรับปรุงผิววัสดุโดยการชุบเคลือบผิว (coating) เป็นวิธีที่มีการนำไปใช้งานกันอย่าง แพร่หลาย มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสวยงาม เพิ่มความแข็งพื้นผิว ความต้านทานการกัดกร่อน ความต้านทานการสึกหรอ ตลอดจนสมบัติในการนำไฟฟ้า การชุบเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้า (electrodeposit) เป็นวิธีการในการเคลือบผิวที่ใช้กันอย่างกว้างขว้างมายาวนาน เนื่องจากข้อดีของ ้วิธีนี้คือ สามารถควบคุมกระบวนการได้ง่าย วัสดุที่ใช้เคลือบมีหลากหลาย มีอัตราการเคลือบที่สูง ในปัจจุบันมีการชุบเคลือบโดยใช้วัสดุโลหะนิกเกิล (Nickel) ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อ เป็นทางเลือกในการที่จะทดแทนการใช้โครเมียม (Chromium) เนื่องจาก ในกระบวนการชุบโครเมียม เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อพิจารณาจากค่าความแข็งของชั้นเคลือบพบว่าชั้น เคลือบนิกเกิลมีค่าความแข็งอยู่ในช่วงประมาณ 2-6 GPa [1, 2] อย่างไรก็ดีสามารถปรับปรุงสมบัติ เชิงกลของนิกเกิลได้จากการเติมธาตุผสม โดยพบว่าชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน (Ni-W) จะมี ค่าความแข็งอยู่ในช่วงประมาณ 5.2-7.1 GPa และมีค่าอัตราการสึกหรอจำเพาะประมาณ 1.8-3.8x10<sup>-15</sup> m<sup>3</sup>(Nm)<sup>-1</sup> [3-5] ชั้นเคลือบนิกเกิลฟอสฟอรัส (Ni-P) มีค่าความแข็งประมาณ 6-7.5 GPa และมีค่าอัตราการสึกหรอจำเพาะประมาณ  $1 \times 10^{-15}$  m<sup>3</sup>(Nm)<sup>-1</sup> [2, 6] ซึ่งไม่สูงมากนักเมื่อ เปรียบเทียบกับวัสดุทั้งสเตนคาร์ไบด์ (WC-12Co) ที่มีความแข็งพื้นผิวสูงประมาณ 10.3-10.5 GPa และมีค่าอัตราการสึกหรอจำเพาะประมาณ 9x10<sup>-17</sup> m<sup>3</sup>(Nm)<sup>-1</sup> [7, 8] ดังนั้นจึงได้มีการหาแนวทางใน ศึกษาและพัฒนาชั้นผิวเคลือบของโลหะในกลุ่มนิกเกิลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้งานในด้านที่มี ้ความต้องการสมบัติด้านความแข็งพื้นผิวและความต้านทานการสึกหรอ เช่น การผลิตแม่พิมพ์สำหรับ ใช้ในงานตีขึ้นรูป อุตสาหกรรมการผลิตหินเจีย เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาสมบัติเชิงกลด้านความแข็งพื้นผิวและความต้านทานการสึกหรอ ของชั้น เคลือบโลหะนิกเกิล ได้มีการศึกษามาบ้างแล้ว โดยมีได้หลายแนวทาง ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ได้ ทำการศึกษาผลของขนาดเกรนของโลหะนิกเกิลต่อสมบัติทางด้านการสึกหรอ [9] พบว่าการลดขนาด เกรนให้อยู่ในระดับนาโน ทำให้ชั้นเคลือบมีค่าความแข็งผิวเพิ่มสูงขึ้นตามหลักการของการเพิ่มความ แข็งแรงโดยการทำให้เกรนละเอียด (grain refinement) และผลจากการทดลองพบว่าค่าความแข็ง พื้นผิวที่เพิ่มขึ้นจากการลดขนาดเกรน ส่งผลทำให้ชั้นเคลือบนิกเกิลมีค่าความต้านทานการสึกหรอ แบบขัดสี (abrasive wear) สูงขึ้น โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปตามสมการของ Archard กล่าวคือ ค่าความแข็งพื้นผิวจะส่งผลโดยตรงต่อความต้านทานการสึกหรอของวัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่ได้ศึกษาถึงผลของปริมาณธาตุทังสเตนในชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนที่มีต่อสมบัติ เชิงกล โดยใช้วิธีการชุบแบบใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบได้จากค่าความ หนาแน่นกระแส พบว่าการเติมธาตุผสมทังสเตนทำให้ได้โครงสร้างผลึกในระดับนาโน โดยที่ปริมาณ ธาตุทังสเตนในชั้นเคลือบที่สูงขึ้น จะส่งผลทำให้เกรนมีขนาดเล็กลง [4, 10-12] ทำให้ชั้นเคลือบมีค่า ความแข็งพื้นผิวสูงขึ้นตามหลักการทฤษฎี Hall-Petch และผลของปริมาณทังสเตนที่เพิ่มขึ้นในชั้น เคลือบที่นำไปทดสอบการสึกหรอแบบไถล (sliding wear) พบว่าปริมาณทังสเตนมีส่วนช่วยทำให้ อัตราการสึกหรอมีค่าลดลง [4, 10-13] และจากงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันยังพบว่าปริมาณทังสเตนใน ชั้นเคลือบทำให้การโตของเกรนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอบอ่อนลดลง เนื่องจากธาตุทังสเตนช่วยให้ โครงสร้างจุลภาคมีเสถียรภาพทางความร้อน (thermal stability)เพิ่มขึ้น [3, 5] นอกจากนี้ยังมี วิธีการในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบ โดยการทำให้ชั้นเคลือบเป็นวัสดุคอมโพสิทจากการ เติมอนุภาคเซรามิกส์เช่น อลูมินา [14] และซิลิกอนคาร์ไบด์ [6] ในวิธีการชุบเคลือบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และพบว่าผลของการเติมอนุภาคเซรามิกส์ในชั้นเคลือบทำให้มีค่าความแข็งพื้นผิวและความต้านทาน การสึกหรอที่สูงขึ้น

แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีแนวทางที่เริ่มมีการศึกษาคือ การชุบเคลือบหลายชั้นแบบสลับชั้น เช่นการชุบเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลฟอสฟอรัสทังสเตน (Ni-P-W) แบบหลายชั้นที่ชั้นเคลือบ ประกอบไปด้วยชั้นที่มีปริมาณทั้งสเตนสูงสลับกับชั้นที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำ [15-18] พบว่าที่ความ หนาผิวเคลือบรวมเท่ากันการชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีชั้นเคลือบบางและมีจำนวนของชั้นเคลือบ มาก ส่งผลทำให้ค่าความต้านทานการสึกหรอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สามารถอธิบายได้โดยพิจารณา จากกลไกการสึกหรอของวัสดุแบบเปราะ พบว่าการมีจำนวนชั้นเคลือบมากจะเป็นการเพิ่มจำนวน ของรอยต่อระหว่างชั้น (interface) ทำหน้าที่เป็นเสมือนอุปสรรคในการขัดขวางทิศทางการโตของ รอยแตก (crack) จึงทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการที่จะทำให้รอยแตกเกิดการโตที่จะนำไปสู่การ เสียหายของวัสดุ ส่งผลทำให้ชั้นเคลือบมีความแกร่ง (toughness) มากขึ้น และงานวิจัยศึกษาการ ชุบเคลือบแบบหลายชั้นแบบสลับชั้นของวัสดุเคลือบสองชนิดที่มีค่าความแข็งพื้นผิวต่างกันคือนิกเกิล และทองแดง พบว่าที่ความหนาผิวเคลือบรวมเท่ากันการที่มีระดับชั้นเคลือบบางและมีจำนวนชั้น เคลือบมาก จะส่งผลทำให้มีค่าความแข็งพื้นผิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีจำนวนรอยต่อระหว่างชั้นมาก จะเป็นการต้านการแปรรูปแบบถาวรของชั้นเคลือบ [19]

เนื่องจากยังมีการศึกษาวิจัยการชุบเคลือบแบบหลายชั้นไม่มากนัก จึงมีความน่าสนใจที่จะ ทำการศึกษาถึงตัวแปรของการชุบเคลือบแบบหลายชั้นแบบสลับชั้น โดยการใช้กระแส reverse pulse และเลือกใช้วัสดุเคลือบโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน (Ni-W) เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความแข็งพื้นผิว ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัสดุเคลือบอื่นในกลุ่มโลหะนิกเกิล และได้เริ่มมีการวิจัยตลอดจนการ นำมาใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ในงานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรในการชุบเคลือบ ที่ส่งผลต่อค่าสมบัติเชิงกลคือ ความแข็งพื้นผิวและค่าความต้านทานการ สึกหรอ ทั้งนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) การหาผลกระทบของความหนาชั้นเคลือบย่อย ที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล 2) การหาผลกระทบของค่าความหนารวมที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล และ 3) การหาผลกระทบของการสลับส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล จากการ ทดลองดังกล่าวจะนำไปพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยตรวจสอบคุณลักษณะของ ชั้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscope) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) เทคนิค EPMA (Electron Probe Micro Analyzer ) ตรวจสอบขนาดเกรนจาก เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction, XRD) ศึกษาสมบัติเชิงกลโดยตรวจสอบค่าความแข็งพื้นผิวด้วยวิธีไมโครวิกเกอร์ (Microvicker hardness) และศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอด้วยเทคนิค ball-on-disc

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการชุบเคลือบหลายชั้นแบบสลับส่วนประกอบทางเคมีของโลหะผสม นิกเกิลทังสเตน ที่ได้จากกระบวนการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้ากระแสช่วงสลับ

 เพื่อศึกษาผลของความหนารวมของชั้นผิวเคลือบ ที่มีผลต่อความแข็งพื้นผิว และอัตราการ สึกหรอ

 เพื่อศึกษาผลของจำนวนชั้นเคลือบนิกเกิลทั้งสเตน ที่มีผลต่อความแข็งพื้นผิว และอัตรา การสึกหรอ

4. เพื่อศึกษาผลของปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบและความแตกต่างของปริมาณทั้งสเตนใน แต่ละชั้นเคลือบ ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล

#### 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430 เป็นวัสดุตั้งต้น และมีการชุบเคลือบนิกเกิลสไตร์ค เพื่อกระตุ้นผิว ตามด้วยการชุบเคลือบนิกเกิลฟอสฟอรัส ชนิดฟอสฟอรัสต่ำ โดยการชุบแบบไม่ใช้ ไฟฟ้า เป็นชั้นรองพื้น

2. ทำการชุบเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้าวัสดุนิกเกิลทั้งสเตนแบบหลายชั้น โดยวิธีการชุบแบบใช้ ไฟฟ้ากระแส reverse pulse ที่มีส่วนผสมในอ่างเคลือบคงที่ อุณหภูมิคงที่ และพีเอชคงที่

3. ศึกษาสมบัติด้านความแข็งพื้นผิว และความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบ

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเข้าใจและอธิบายถึงหลักการของกระบวนการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้ากระแส reverse pulse และแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

 สามารถอธิบายถึงอิทธิพลของตัวแปรการชุบเคลือบแบบหลายชั้น ที่มีผลต่อค่าความแข็ง พื้นผิว และความต้านทานการสึกหรอ

3. สามารถที่จะทำนายและควบคุมโครงสร้างจุลภาคของชั้นผิวเคลือบได้ จากการชุบเคลือบ แบบใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้กระแส reverse pulse

 4. นำแนวทางที่ได้จากการศึกษาการชุบเคลือบแบบหลายชั้น ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับอุตสาหกรรมการผลิตหินเจียรได้

# บทที่ 2 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

## 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะแสดงทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการชุบโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนโดยวิธีชุบ ไฟฟ้า ได้แก่ ทฤษฎีในเรื่องการชุบไฟฟ้า การใช้กระแสช่วงสลับ การชุบเคลือบแบบหลายชั้น และ สมบัติที่สำคัญของชั้นเคลือบ เช่น ความแข็งผิวและการสึกหรอ

#### 2.1.1 นิกเกิล

นิกเกิล [20] (Nickel) สัญลักษณ์ธาตุคือ Ni เป็นโลหะที่มีความต้านทานต่อการเกิด ออกซิเดชันและการกัดกร่อนสูง เป็นโลหะที่มีสีขาวสวยงาม มีความเหนียวและอ่อนตัวสูงสามารถขึ้น รูปเย็นได้โดยง่าย นอกจากนี้นิกเกิลสามารถละลายกับโลหะอื่นได้ง่ายและให้สารละลายของแข็งที่มี ความเหนียว นิกเกิลนิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมนิกเกิลที่ใช้งานพิเศษที่ ทนการกัดกร่อนสูง ๆ และใช้เคลือบลงบนผิวเหล็ก โดยอาศัยสมบัติด้านทนต่อการกัดกร่อนและให้ สารละลายของแข็งได้ง่าย โดยส่วนใหญ่ไม่ใช้นิกเกิลในสภาพโลหะบริสุทธิ์ เพราะนิกเกิลมีราคาสูงเมื่อ เทียบกับโลหะชนิดอื่น ๆ จะใช้ในลักษณะโลหะผสม และเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่ออาศัย คุณสมบัติพิเศษของนิกเกิลเท่านั้น

สมบัติโลหะนิกเกิล		
ระบบโครงสร้างผลึก	FCC (F	ace center cubic)
น้ำหนักอะตอม	58.69	g/mol
ความหนาแน่น (density)	8.89	g/cm <sup>3</sup>
อุณหภูมิหลอมเหลว	1435-1	455 °C
จุดเดือด	2730	°C
ความร้อนจำเพาะ (27-100 <sup>°</sup> C)	0.13	cal/g °C
ความร้อนแฝงของการหลอมละลาย	73.8	cal/g
ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (20 <sup>°</sup> C)	9.5 mi	crohm∙cm
สัมประสิทธิ์ตัวนำความร้อน (27-100 <sup>°</sup> C)	0.145	cal·cm/cm <sup>2</sup> ·s·°C
ความต้านทานแรงดึง (tensile strength)	47	kg/mm <sup>2</sup>

พิกัดความยืดหยุ่น (elastic limit)	15	kg/mm <sup>2</sup>
อัตราการยึดตัว (percent elongation)	40%	
ความแข็ง (hardness)	110	HB.
โมดูลัสของการยืดหยุ่น (modulus of elasticity)	21000	kg/mm <sup>2</sup>

#### 2.1.2 ทั้งสเตน

ทั้งสเตน [20] (Tungsten) สัญลักษณ์ธาตุคือ W เป็นโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง โลหะ ผสมทั้งสเตนมีคุณสมบัติที่ดีในการคงความแข็งที่อุณหภูมิสูง ใช้เป็นธาตุผสมในเหล็กกล้าความเร็วสูง (high speed steel) นอกจากนี้ ยังใช้ในรูปสารประกอบคาร์บอนในรูปทั้งสเตนคาร์ไบด์ ซึ่งเป็น สารประกอบเชิงโลหะที่มีค่าความแข็งผิวที่สูงมากใช้ทำเครื่องมือตัดโลหะ โลหะทั้งสเตนมีราคาแพง ถูกจัดไว้ในประเภทโลหะทนความร้อน (refractory metal)

<u>คุณสมบัติโลหะทั้งสเตน</u>		
ระบบโครงสร้างผลึก	BCC (b	ody center cubic)
น้ำหนักอะตอม	184	g/mol
ความหนาแน่น	19.32	g/cm <sup>3</sup>
อุณหภูมิหลอมเหลว		3400 °C
จุดเดือด	5900	°C
ความร้อนจำเพาะ (25 <sup>°</sup> C)	0.034	cal/g°C
ความแข็ง		400 HB.
โมดูลัสของการยืดหยุ่น	35200	kg/mm <sup>2</sup>
ความต้านทานแรงดึง	70	kg/mm <sup>2</sup>

## 2.1.3. การเคลือบผิววัสดุ (suface coating)

การเคลือบผิววัสดุ [21] เป็นกระบวนการปรับปรุงผิววัสดุเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความสวยงาม ความแข็งผิว ความต้านทานการกัดกร่อน โดยมีวิธีการที่หลากหลายดังแสดงใน ตารางที่ 2.1 ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน และสภาวะที่เหมาะสมเช่น อุณหภูมิการชุบเคลือบ และค่า ความหนาของชั้นเคลือบที่ได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 อีกทั้งยังมีลักษณะการชุบที่หลากหลายดังแสดง ในภาพที่ 2.2

ตารางที่ 2. 1 ลักษณะการชุบเคลือบผิวแบบต่าง ๆ [21]

Physical and chemical vapour deposition	Thin discrete coating; no limitations on materials
Ion implantation	Thin diffuse coating; mixing with substrate inevitable
Surface welding	Suitable for very thick coatings only; limited to materials stable at high temperatures; coated surfaces may need further preparation
Thermal spraying	Very thick coatings possible but control of coating purity is difficult
Laser glazing and alloying	Thick coatings; coating material must be able to melt
Friction surfacing	Simple technology but limited to planar surfaces; produces thick metal coating
Explosive cladding	Rapid coating of large areas possible and bonding to substrate is good. Can give a tougher and thicker coating than many other methods
Electroplating	Wide range of coating thicknesses, but adhesion to substrate is poor and only certain materials can be coated by this technique



ภาพที่ 2. 1 ช่วงการเคลือบโดยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก) ความหนาผิวเคลือบ ข) อุณหภูมิในการเคลือบผิว [21]



## ภาพที่ 2. 2 ตัวอย่างการเคลือบด้วยวิธีการชุบไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ [1]

## 2.1.4 การชุบเคลือบผิวโลหะโดยวิธีการแบบใช้ไฟฟ้า

อัญรูปและคุณสมบัติของชั้นเคลือบที่ได้จากวิธีการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้า มีตัวแปรที่ เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ส่วนประกอบเคมีในอ่างสารละลายอิเล็คโตรไลต์ (electrolyte) ที่ประกอบไป ด้วยผลจากสารที่เติมลงไปในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ วิธีการของลักษณะการให้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ชุบ เคลือบ ความหนาชั้นเคลือบ อุณหภูมิของสารละลายอิเล็คโตรไลต์ ค่าพีเอช เป็นต้น

การซุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้า เป็นวิธีการชุบเคลือบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อดีของ การชุบเคลือบผิวโดยวิธีการแบบใช้ไฟฟ้า คือ สามารถควบคุมกระบวนการได้ง่ายโดยการควบคุม กระแสไฟฟ้า มีอัตราการชุบเคลือบที่รวดเร็ว มีความหลากหลายในการใช้วัสดุที่จะนำมาเคลือบ ทำให้สมบัติเชิงกลของผิวเคลือบที่ได้จะมีความหลากหลายที่จะเหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท ตัวอย่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ของการเคลือบโลหะบริสุทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 2.2 และคุณสมบัติทางด้านความแข็งผิวของโลหะและโลหะผสมแต่ละประเภทที่ได้จากการ ชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้าดังแสดงในภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2. 3 ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบที่ได้จากการชุบไฟฟ้าของโลหะและโลหะผสม [1]

ตารางที่ 2. 2 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสารละลายอิเล็คโตรไลต์ ในการชุบโลหะแบบใช้ไฟฟ้าและ คุณสมบัติของชั้นเคลือบ [1]

Deposited metal	Example electrolyte and plating conditions	Typical properties and applications
Chromium	CrO₃ (250–400 g dm <sup>-3</sup> ) SO₄²- (2.5–4 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 20–30 °C Current density, 10–30 A dm <sup>-2</sup>	Applied, predominantly in the automotive, aerospace and mining industries, to increase wear, abrasion, corrosion and fretting resistance, reduce static and kinetic friction, reduce seizing of threaded parts, fill undersize or worn parts
Cobalt	CoCl₂·6H₂O (90–105 g dm <sup>-3</sup> ) H₃BO₃ (60 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 50–55 °C Current density. 3–4 A dm <sup>-2</sup>	Wear-resistant coatings
Copper	CuSO₄·5H₂O (150–250 g dm <sup>-3</sup> ) H₂SO₄ (38–62 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 20–60 °C Current density. 3–10 A dm <sup>-2</sup>	Widely deposited for electronics applications. Copper is also used for forming deposits on plastic substrates
Nickel	'Watts nickel' NiSO₄·6H₂O (225–375 g dm <sup>-3</sup> ) NiCl₂·6H₂O (30–60 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 45–65 °C Current density, 2 5–10 A dm <sup>-2</sup>	Wear, abrasion and corrosion (particularly in alkaline conditions) resistance
Silver	Ag (35–120 g dm <sup>-3</sup> ) AgCl (45–150 g dm <sup>-3</sup> ) KCN (70–230 g dm <sup>-3</sup> ) K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> (15–90 g dm <sup>-3</sup> ) KNO <sub>3</sub> (40–60 g dm <sup>-3</sup> ) KOH (4–30 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 35–50 °C	Printed circuits
Zinc	Current density, 0.5–10 A dm <sup>-2</sup> ZnSO <sub>4</sub> (240–480 g dm <sup>-3</sup> ) NaCl (15–30 g dm <sup>-3</sup> ) H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (20–100 g dm <sup>-3</sup> ) Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> ·18H <sub>2</sub> O (25–35 g dm <sup>-3</sup> ) Temperature, 25–30 °C Current density, 0.5–3 A dm <sup>-2</sup>	Corrosion protection

กระบวนการชุบไฟฟ้า เป็นกระบวนการที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา รีดักชั่น (reduction) ของอิออนโลหะในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ โดยการที่อิออน (ion) ของโลหะมี การรับอิเล็กตรอน แล้วเกิดเป็นโลหะในสถานะของแข็ง เคลือบลงบนผิวชิ้นงานที่ต่อกับขั้วลบหรือ แคโทด (cathode) และขั้วบวกหรือแอโนด (anode) จะใช้โลหะที่มีความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยา เช่น แพลทินัม (Pt) เพื่อใช้เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนสู่สารละลายอิเล็คโตรไลต์



#### ภาพที่ 2. 4 ภาพจำลองอ่างชุบเคลือบโลหะแบบใช้ไฟฟ้า

เมื่อมีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ จะทำให้อิออนในสารละลาย อิเล็คโตรไลต์ ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุเกิดการแยกตัว โดยอนุภาคประจุลบเรียกว่า แอนอิออน (anion) จะวิ่งไปที่ขั้วแอโนด อนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า แคทอิออน (cation) จะวิ่งไปที่ขั้วแคโทด ซึ่งกระบวนการแยกสลายดังกล่าวไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะสามารถ สังเกตเห็นฟองแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วแอโนด และสังเกตเห็นฟองแก๊สไฮโดรเจนที่บริเวณ ขั้วแคโทด เมื่อมีการต่อกระแสไฟฟ้าครบวงจร

## 2.1.4.1 โลหะที่นิยมนำมาชุบไฟฟ้า

#### 2.1.4.1.1 โครเมียม

โครเมียมเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ชุบเคลือบกันอย่างแพร่หลาย สำหรับการใช้งาน สำหรับการต้านทานการสึกหรอ การกัดเซาะ ตลอดจนต้านทานการกัดกร่อน ผิวเคลือบ โครเมียมที่ได้จะมีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานต่ำ และมีค่าความแข็งพื้นผิวที่สูง สมบัติต่าง ๆ เช่น โครงสร้างจุลภาค ความแข็งผิว รอยแตกความเค้นคงค้าง (residue stress crack) และความแวววาวของผิวเคลือบ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความหนาแน่นกระแส และ อุณหภูมิ [1] โดยทั่วไปการชุบเคลือบโครเมียมจะแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ โครเมียมแข็ง (hard chromium) ที่จะมีค่าความแข็งพื้นผิวสูง ความต้านทานการขัดสีสูง แต่มีค่าความ ต้านทานการกัดกร่อนที่ต่ำ เนื่องจากมีระดับของการรอยแตกในชั้นเคลือบที่มาก และ โครเมียมเงา (bright chromium) ที่จะไม่มีรอยแตกอยู่ภายในชั้นเคลือบ (crack free) ทำ ให้มีค่าความต้านทานการกัดกร่อนที่สูง แต่จะมีค่าความแข็งพื้นผิวและค่าความต้านทานการ ขัดสีที่ไม่สูงนัก

#### 2.1.4.1.2 นิกเกิล

นิกเกิล โดยทั่วไปเป็นวัสดุที่ใช้ชุบเคลือบสำหรับงานที่ต้องการความสวยงานทางด้าน สถาปัตยกรรม โดยมีความแววววาวด้วยตัวของมันเอง อีกทั้งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการ นำมาใช้ในการชุบเคลือบโลหะผสมที่ใช้ในงานทางด้านการต้านทานการสึกหรอ การต้านทาน การขัดสี และโดยเฉพาะการต้านทานการกัดกร่อนในสภาวะอัลคาไลน์

#### 2.1.4.2 กฎฟาราเดย์

ในกระบวนการชุบเคลือบที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสารละลายอิเล็ก โตรไลต์โดยทางแคโทดและแอโนด โลหะที่ขั้วแอโนดจะมีการสลายตัวเป็นอิออน เกิดเป็นอิออนบวก และจะวิ่งไปที่ขั้วแคโทด เกิดการรับอิเล็กตรอน เกิดเป็นโลหะของแข็งยึดเกาะที่ขั้วแคโทด ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นที่ขั้วทั้งสอง มีความสัมพันธ์กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใช้และระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหล ผ่าน เป็นไปตามกฎของฟาราเดย์ [22] ดังนี้

กฎข้อที่ 1 น้ำหนักของอิออนที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรง กับปริมาณของไฟฟ้าที่ใช้

กฎข้อที่ 2 น้ำหนักของอิออนชนิดต่างๆที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระโดยปริมาณไฟฟ้าเท่าๆกัน จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสมมูลย์เคมีของอิออนเหล่านั้น

จากความสัมพันธ์ดังกล่าวในกฎข้อที่หนึ่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ในกระบวนการชุบ เคลือบผิวโลหะได้ เช่น ถ้าต้องการเพิ่มความหนาจากปริมาณการเคลือบของโลหะ อาจใช้การเพิ่ม ระยะเวลาในการชุบโดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ๆ หรือ การใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณมากแต่ระยะเวลาใน การชุบน้อย ซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณโลหะไปเกาะปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น และจากความสัมพันธ์ ของกฎข้อที่สอง โลหะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการแยกสลายแตกต่างกัน โลหะบางชนิดมีความสามารถ ในการสลายตัวน้อย โลหะบางชนิดมีความสามารถในการสลายตัวมาก ทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าค่า หนึ่งจะทำให้โลหะต่างชนิดกันแยกสลายตัวออกมาปริมาณต่างกัน

การคำนวณหาปริมาณโลหะที่ไปเกาะที่แคโทด โดยใช้กฎของฟาราเดย์

 $W = I \bullet T \bullet A / Z \bullet F$ 

(สมการที่ 2.1)

W คือ ปริมาณโลหะที่ไปเกาะที่แคโทด

I คือ กระแสไฟฟ้า

T คือ เวลาที่ใช้ในการชุบเคลือบผิว

A คือ น้ำหนักอะตอมของโลหะ

Z คือ จำนวนวาเลนต์ของโลหะ

F คือ ค่าคงที่ของฟาราเดย์ (96485 คูลอมบ์)

## 2.1.4.3 ขั้ว

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ไหลผ่านไปยังน้ำยาชุบสารละลายของอิเล็คโตรไลต์ ไม่ได้ถูกใช้ในการ แยกสลายอิออนโลหะเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องสูญเสียไปกับการแยกสลายสารอื่น ๆ ที่อยู่ใน สารละลายอิเล็คโตรไลต์ เช่น แก๊สไฮโดรเจน เป็นต้น ส่งผลทำให้ในกระบวนการผลิตจริงพบว่า การชุบเคลือบที่ได้มีปริมาณของโลหะที่เคลือบลงบนขั้วแคโทดน้อยกว่าตามทฤษฎีกฎข้อที่หนึ่งของ ฟาราเดย์ โดยหากเอาน้ำหนักของแคทอิออนที่ไปเกาะที่ขั้วลบของจริง มาเปรียบเทียบกับน้ำหนัก ของโลหะที่ควรจะไปเกาะที่ขั้วลบตามทฤษฎี ก็จะสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของขั้วลบได้ โดยประสิทธิภาพของขั้วลบของน้ำยาชนิดต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไป เช่น น้ำยาชุบโครเมียมจะมี ประสิทธิภาพขั้วลบต่ำมาก คือประมาณ 10-25% เท่านั้น น้ำยาชุบเงินมีประสิทธิภาพขั้วลบสูงมาก คือเกือบ 100% เป็นต้น [22]

## *2.1.4.4 พีเอช* (pH)

น้ำบริสุทธิ์ มีสูตรโมเลกุลคือ H<sub>2</sub>O โดยทั่วไปจะมีค่าพีเอชเป็นกลางคือเท่ากับ 7 โดยที่น้ำ 1 โมเลกุลจะประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ในการแยกสลายด้วยไฟฟ้า น้ำบางส่วนจะสามารถแยกสลายออกได้เป็น ไฮโดรเจนอิออน และไฮดรอกซิลอิออน ดังสมการ

H<sub>2</sub>O = H<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup> (สมการที่ 2.2)

ในน้ำบริสุทธิ์ที่เป็นกลาง จะมีจำนวนของไฮโดรเจนอิออน และไฮดรอกซิลอิออนเท่ากัน แต่ถ้าในน้ำที่มีไฮโดรเจนอิออนมากกว่าไฮดรอกซิลอิออน น้ำนั้นจะมีสภาพเป็นกรด ค่า pH ตั้งแต่ 7 ลงมาถึง 1 และในทางตรงกันข้ามถ้าในน้ำมีไฮดรอกซิลอิออนมากกว่าไฮโดรเจนอิออน น้ำนั้นก็จะมี สภาพเป็นด่าง พีเอชตั้งแต่ 7 ถึง 13

ค่าพีเอชนั้นมีผลต่อน้ำยาชุบมาก ถ้าค่าของพีเอชน้อย แสดงว่าน้ำยานั้นมีสภาพเป็นกรดมาก เกินไป จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของแคโทดลดต่ำลง แต่ถ้าค่าของพีเอชมาก น้ำยาจะมีสภาพเป็น ด่างมากเกินไป จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของแอโนดลดต่ำลงเช่นกัน ดังนั้นการควบคุมค่าพีเอชจึงมี ความสำคัญมาก ซึ่งน้ำยาชุบทุกชนิดจะมีค่าพีเอชที่เหมาะสมอยู่ค่าหนึ่ง ในการใช้งานควรควบคุมค่า พีเอชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้านั้นหากน้ำยาชุบมีสภาพเป็นกรดมาก เกินไป หรือมีค่าพีเอชลดลงจะมีผลกระทบต่อความเงาและมีแนวโน้มที่จะเกิดรูพรุนขึ้น แต่ถ้ามีค่าพี เอชสูงเกินไปนิกเกิลที่ได้จะมีความยืดหยุ่นต่ำ ดังนั้นการควบคุมค่าพีเอชของสารละลายไว้จึงมี ความสำคัญมากซึ่งการลดค่าพีเอชลงทำได้โดยการเติมกรดซัลฟิวริกหรือไฮโดรคลอริก และการเพิ่มค่า พีเอชโดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์

## 2.1.4.5 ความหนาแน่นของกระแส (current density)

ความหนาแน่นของกระแสในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า [22] ซึ่งก็คือ ความหนาแน่นกระแสที่ ช่วยให้เกิดการเคลือบที่ขั้วแคโทดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยปกติมักจะกำหนดค่าในหน่วยของแอมแปร์ ต่อตารางฟุต หรือแอมแปร์ต่อตารางเดซิเมตร ดังนั้นการคำนวณหาพื้นที่ของชิ้นงานที่ถูกต่อกับขั้ว แคโทดที่จะทำการชุบโลหะ เพื่อที่จะกำหนดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากแต่ละชิ้นงานจะมีพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความต้องการกระแสไฟฟ้าที่ใช้แตกต่างกัน

ความหนาแน่นของกระแสของขั้วลบ คือกระแสที่ช่วยให้เกิดการเคลือบที่ขั้วลบต่อหนึ่งหน่วย พื้นที่ ปกติมักใช้แอมแปร์ต่อตารางฟุต หรือแอมแปร์ต่อตารางเดซิเมตร การคำนวณหาพื้นที่ของ แคโทด เพื่อทราบว่าจะจ่ายความหนาแน่นของกระแสแตกต่างกันออกไป และงานแต่ละชิ้นก็มีเนื้อที่ แตกต่างกันด้วยเหตุนี้กระแสและเนื้อที่จึงควรต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ

## 2.1.4.6 กระแสแบบ pulse

เป็นวิธีการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าที่จ่ายกระแสแบบ pulse [23] ส่งผลทำให้เกิดการกระจายตัว ของการเคลือบผิวของอิออนที่วัสดุพื้น ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระแสมีการกระจายตัวได้ สม่ำเสมอขึ้น ทำให้ผิวเคลือบที่ได้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น และยังช่วยในเรื่องความเงาของผิวเคลือบ อีกด้วย

ในวิธีการชุบเคลือบแบบ pulse ค่าศักย์ไฟฟ้าหรือกระแส จะมีการสลับไปมาระหว่างสองค่า ที่มีค่าแอมปลิจูดของช่วงที่เท่ากัน ซึ่งในแต่ละช่วงจะประกอบไปด้วย เวลาเปิด ในระหว่างที่มีการให้ กระแสไฟฟ้าเข้าไป และเวลาปิด ในระหว่างที่ค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ ดังแสดงในภาพที่ 2.5





มีความเป็นไปได้ที่จะใช้การกำหนดลักษณะการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการใช้ควบคุม ส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบ และความหนาผิวเคลือบ เนื่องจากการใช้การจ่ายกระแสไฟฟ้า แบบ pulse ส่งผลทำให้มีการเกิดนิวคลีเอชั่นเพิ่มขึ้น โดยจะมีจำนวนเกรนต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ได้ ชั้นเคลือบที่มีเกรนละเอียด และมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าวิธีการชุบเคลือบแบบใช้กระแสตรงทั่วไป โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ กระแสแบบ pulse และกระแส reverse pulse ดังแสดงในภาพที่ 2.6 กระแสจะถูกขัดจังหวะโดยกระแสแบบ reverse pulse



## ภาพที่ 2. 6 รูปแบบการชุบเคลือบแบบ reverse pulse [23]

การใช้กระแส reverse pulse ช่วยในการเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของอ่างเคลือบ โดยการลดความต้องการของการเติมสารเติมแต่ง การกำจัดความหนาที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีความ หนาแน่นกระแสมาก ในระหว่างการผกผันของกระแส และปรับปรุงโครงสร้างให้มีชั้นเคลือบที่ ปราศจากรูพรุน โดยประสิทธิภาพของกระแสแบบ reverse pulse จะมีค่าต่ำกว่าประสิทธิภาพของ กระแสปกติ แต่การใช้กระแส reverse pulse ส่งผลต่อโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของชั้น เคลือบที่มีความสม่ำเสมอจากการซุบเคลือบที่ความถี่สูง (>10 Hz.) การชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้ากระแส reverse pulse สามารถนำไปใช้ในการชุบเคลือบกับวัสดุ ได้หลากหลายชนิด เช่น นิกเกิล การชุบเคลือบนิกเกิลแบบใช้ไฟฟ้ากระแส reverse pulse สามารถ ทำให้เกิดชั้นเคลือบของนิกเกิลที่มีความบางมากได้ และไร้รูพรุน การชุบเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิล ทังสเตน ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันสูงจากการลดปริมาณทังสเตน ตลอดจนการชุบเคลือบวัสดุชั้น เคลือบคอมโพสิทนิกเกิลซิลิคอนคาร์ไบด์ การใช้กระแส reverse pulse ช่วยในการปรับปรุงปริมาณ การใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ได้ ชั้นเคลือบคอมโพสิทที่ได้จากการใช้กระแส reverse pulse จะมีค่าความแข็ง พื้นผิว 611 HV ซึ่งมีค่ามากกว่าการชุบเคลือบแบบกระแสตรงปกติที่มีค่าความแข็งพื้นผิว 540 HV

#### 2.1.5 การชุบนิกเกิลสไตร์ค (Nickel strike)

นิกเกิลสไตร์ค [22] เป็นการชุบที่จะได้ชั้นเคลือบบาง ๆ โดยทั่วไปจะใช้ชุบเคลือบลงบน ชิ้นงานประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากเหล็กกล้าไร้สนิมมีออกไซด์อยู่บริเวณผิว ดังนั้นก่อนทำการ ชุบนิกเกิลสไตร์คจึงต้องมีการขัดผิวก่อน การชุบนิกเกิลสไตร์คเป็นการกระตุ้นผิวก่อนที่จะนำไป ชุบเคลือบในขั้นต่อไป

## 2.1.5.1 นิกเกิลสไตร์ค ชนิดคลอไรด์

สูตร	นิกเกิลคลอไรด์ (NiCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O)	240 กรัม/ลิตร
	กรดไฮโดรคลอริค(HCl)	86 มิลลิลิตร/ลิตร
	ความหนาแน่นกระแส	3 แอมป์/ตารางเดซิเมตร
	อุณหภูมิ	อุณหภูมิห้อง
	เวลาชุบ 2-3 นาที่ใช้งานเ	ป็นขั้วบวก และ 6 นาที ใช้งานเป็นขั้วลบ
2.1.5.2	น นิกเกิลสไตร์ค ชนิดซัลเฟต	
สูตร	นิกเกิลซัลเฟต (NiSO₄·6H₂O)	250 กรัม/ลิตร
	กรดซัลฟิวริก (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	25 มิลลิลิตร/ลิตร
	กระแสไฟฟ้า	16-22 แอมป์/ตารางเดซิเมตร
	อุณหภูมิ	35-40 องศาเซลเซียส
	เวลาซุป	5-10 นาที

#### 2.1.6 สมบัติเชิงกลที่สำคัญของการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้า

สำหรับการชุบเคลือบโลหะ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในหลักการของวัสดุศาสตร์ ในด้านของสมบัติ วัสดุ คือ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างจุลภาค และสมบัติของวัสดุ ความแตกต่างกันของโครงสร้าง จุลภาคจะส่งผลต่อกลไกด้านสมบัติเชิงกลของวัสดุ ทำให้วัสดุมีค่าสมบัติที่แตกต่างกัน โดยสมบัติ เชิงกลที่สำคัญ คือ ความแข็งแรง ความเหนียว ความแข็งผิว

#### 2.1.6.1 ความแข็งผิว

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเกรนของโลหะ และค่า ความแข็งพื้นผิว สามารถอธิบายได้โดยใช้สมการของ Hall-Petch [24, 25] ดังนี้

н	=	H <sub>0</sub>	$+ K_{H} \cdot D^{-1/2}$	(สมการที่ 2.3)

- H คือ ค่าความแข็งผิวของวัสดุหลายผลึก
- H<sub>0</sub>, K<sub>H</sub> คือ ค่าคงที่ของวัสดุ
- D คือ ขนาดเกรนของวัสดุ

โดยที่ H<sub>0</sub> และ K<sub>H</sub> เป็นค่าคงที่ที่ได้จากการทดลอง และเป็นค่าเฉพาะของวัสดุโลหะแต่ละ ชนิดโดยสมการนี้ใช้ได้กับวัสดุหลายผลึกโดยทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2. 7 ความสัมพันธ์ของ Hall-Petch ของชั้นเคลือบโลหะชนิดต่าง ๆ [25]

การซุบเคลือบนิกเกิลโดยวิธีแบบใช้ไฟฟ้า จะมีความสัมพันธ์ตามทฤษฎีของ Hall-Petch สำหรับช่วงขนาดเกรน 12500 – 12 นาโนเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2.8 โดยจะมีค่าความแข็งผิวที่ สูงสุดคือ 700 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร



ภาพที่ 2. 8 ค่าความแข็งผิวที่สัมพันธ์กับขนาดเกรนของชั้นเคลือบนิกเกิล [25]

#### *2.1.6.2* การสึกหรอ

การสึกหรอเป็นสมบัติเชิงกลที่มีความสำคัญมาก แต่ในความเป็นจริงนั้นการศึกษาถึงกลไก การสึกหรอนั้นยังมีความซับซ้อนและไม่แน่ชัด การสึกหรอเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของ วัสดุในสถานะของแข็ง อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าพื้นผิววัสดุ และผิวสัมผัสของ ชิ้นงาน มีความเสียหายคือการสูญเสียเนื้อวัสดุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนเนื่องจากไม่ สามารถที่จะสังเกตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัด ตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้องในกลไกการสึกหรอ คือ ค่าความแข็งผิว โครงสร้างจุลภาค พื้นที่ผิวสัมผัส รูปร่างของวัสดุ โดยการสึกหรอสามารถแบ่ง ได้เป็นสี่ประเภทตามลักษณะของกลไก [26] ดังแสดงในภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2. 9 แผนภาพแสดงการสึกหรอในลักษณะต่าง ๆ [25]

2.1.6.2.1 การสึกหรอแบบขัดสี (abrasion)

เป็นกลไกที่เกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของวัสดุกับอนุภาคแข็ง จากการสัมผัสกันภายใต้ แรงกระทำ เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากการเคลื่อนผ่านของอนุภาคแข็งผ่านผิวสัมผัส เช่น การขัดผิวขึ้นงานโลหะด้วยกระดาษทราย เป็นต้น โดยการสึกหรอแบบขัดสี มีกลไกที่สำคัญ 4 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 2.10 โดยที่สำหรับวัสดุโลหะจะเกิดกลไกของ cutting และ ploughing แต่กลไก fracture และ grain pull-out จะเกิดในวัสดุเซรามิกส์



## ภาพที่ 2. 10 กลไกการสึกหรอแบบขัดสี [26]

การจำแนกกลไกการสึกหรอแบบขัดสี

- Cutting เป็นการแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ของวัสดุ
- Fracture เป็นการแตกหักภายในเนื้อวัสดุ
- Fatigue by repeated ploughing เป็นการแยกออกของเนื้อวัสดุ ลักษณะรูปตัววี
- Grain pull-out เป็นการหลุดของเนื้อวัสดุในลักษณะเป็นเกรน

2.1.6.2.2 การสึกหรอแบบกัดเซาะ (erosion)

เป็นการสึกหรอที่เกิดขึ้นจากกลไกการกระแทกของอนุภาคของแข็งภายใต้ตัวกลางที่ มีการเคลื่อนที่ หรืออนุภาคของเหลวที่มีความเร็วสูง ความเสียหายเกิดขึ้นจากการตกกระทบ ของอนุภาคกับผิววัสดุ เช่น การสึกหรอที่เกิดขึ้นภายในท่อ ระบบปั๊ม กลไกที่ควบคุมการ สึกหรอแบบกัดเซาะคือ สมบัติของอนุภาค รูปทรง อัตราการพุ่งชน ขนาดอนุภาค ความเร็ว และมุมตกกระทบ โดยถ้าค่ามุมตกกระทบคือศูนย์องศาจะเปรียบได้กับการสึกหรอแบบขัดสี ตัวอย่างดังแสดงในภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2. 11 ลักษณะการสึกหรอแบบกัดเซาะ [26]

#### 2.1.6.2.3 การสึกหรอแบบเกาะติด (adhesion)

การสึกหรอแบบเชื่อมติดจัดเป็นการสึกหรอที่มีความรุนแรงมาก เมื่อเทียบกับการ สึกหรอแบบขัดถู เป็นการสึกหรอที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเนื่องจากมีอัตราการ สึกหรอที่สูง มักพบในวัสดุประเภทโลหะ เกิดจากการที่ผิวสัมผัสกันและมีการเกิดพันธะทำ ให้มีการเชื่อมติดกันของผิววัสดุและทำให้มีการฉีกขาดของเนื้อวัสดุเมื่อวัสดุทั้งสองหลุดออก จากกัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสึกหรอแบบเกาะติด สามารถสังเกตได้จากชั้นผิวหน้าที่ มีการหลุดออกไปติดกับวัสดุที่มาเกาะติด เรียกว่า transfer film โดยที่การเกาะติดจะเกิดได้ ดีกับวัสดุชนิดเดียวกัน

การสึกหรอแบบเกาะติดสามารถลดความรุนแรงลงได้จากการใช้สารหล่อลื่น (lubricant) เพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์เสียดทาน (friction coefficient) ระหว่างผิวของวัสดุทั้ง สองชนิด หรือการที่อยู่ในสภาวะที่มีสิ่งเจือปนเช่นน้ำ ที่ทำให้เกิดชั้นออกไซด์บริเวณผิวหน้า วัสดุทำหน้าที่เป็นตัวกลางป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงของผิววัสดุ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ ต่างชนิดกันเพื่อลดโอกาสการเกิดพันธะ กลไกการเกิดการสึกหรอแบบเกาะติดดังแสดงใน ภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2. 12 กลไกการสึกหรอแบบเกาะติด [26]

2.1.6.2.4 การสึกหรอโดยกลไกการล้า (surface fatigue)

การสึกหรอที่เกิดจากการล้า จัดเป็นการสึกหรอที่มีอัตราความเสียหายต่ำ เป็นการ สึกหรอที่เกิดขึ้นจากการกระทำซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของความเสียหาย จากการโตของรอยแตกอย่างช้า ๆ โดยความเสียหายจะเกิดที่บริเวณผิวด้านบนก่อน โดยมากความเสียหายจะทำมุม 45 องศากับผิวชิ้นงาน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเค้น มากสุด ดังแสดงในภาพที่ 2.13



## ภาพที่ 2. 13 กลไกการสึกหรอที่เกิดจากการล้า [26]

เมื่อมีการสึกหรอเกิดขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของวัสดุหรือเครื่องมือ นั้น ๆ ลดน้อยลง และนำไปสู่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับวัสดุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ พิจารณาค่าความต้านทานการสึกหรอของวัสดุก่อนการเลือกนำไปใช้งาน โดยการสึกหรอของ ชั้นเคลือบวัสดุต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 2.14



ภาพที่ 2. 14 ปริมาตรการสึกหรอต่อหน่วยเวลาของผิวเคลือบวัสดุชนิดต่าง ๆ [25]

## 2.1.7 ชั้นเคลือบแบบหลายชั้น (multilayer)

ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี (Composition Modulated Multilayer Coating, CMMC) [25-27] เป็นวิธีการที่มีความน่าสนใจเนื่องจากโครงสร้างที่มีลักษณะ พิเศษเฉพาะ ประกอบด้วยชั้นเคลือบบางในระดับนาโนเมตรจำนวนมากต่อกัน ทำให้ส่งผลต่อค่า สมบัติเชิงกลในด้านความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้น โดยในการชุบเคลือบแบบหลายชั้นสามารถทำได้โดย วิธีการชุบไฟฟ้า โดยภายในชั้นเคลือบอาจมีการสลับชั้นของวัสดุที่ใช้ชุบเคลือบเพื่อทำให้ชั้นเคลือบ
กลายเป็นวัสดุคอมโพสิท ทำให้โครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบโลหะจะประกอบด้วยชั้นบางในระดับ นาโนเมตร ที่มีส่วนประกอบเชิงเคมีที่แตกต่างกัน สำหรับระบบที่ประกอบด้วยชั้นเคลือบวัสดุสองชนิด สลับกัน จะช่วยในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลในด้านการต้านทานการสึกหรอ

ผลที่แสดงถึงโครงสร้างนาโนคอมโพสิท ที่ได้จากการชุบเคลือบวัสดุโลหะสองชนิดคือนิกเกิล และทองแดง ที่ส่งผลทำให้ค่าความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการลดของค่าความหนาของแต่ละชั้น เคลือบ โดยที่ค่าความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากค่าความต้านทานในการแปรรูป และ lattice parameter mismatch ส่งผลทำให้เกิดความความเค้น ความไม่เข้ากันของดิสโลเคชั่น และส่งผลต่อ ความสามารถในการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น ทำให้มีค่าความเค้นจุดคราก (yield strength) ลดลง เมื่อมีการเพิ่มความหนาของชั้นผิวเคลือบ โดยทั่วไประบบจะมีสมบัติเชิงกลที่ต่างจากวัสดุต้นแบบเดิม ดังแสดงในภาพที่ 2.15 ที่มีค่าความแข็งพื้นผิวเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2.9 GPa ไปเป็น 5.6 GPa ซึ่งมี ค่ามากกว่าวัสดุนิกเกิลหรือทองแดง





การศึกษากลไกการสึกหรอของชั้นเคลือบที่มีการสลับส่วนประกอบเชิงเคมี ทำให้ได้ โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ รอยต่อระหว่างชั้นอาจป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอ ทำให้โครงสร้างแบบหลายชั้นสนับสนุนการต้านทานการสึกหรอของชั้นผิวเคลือบ ค่าการสึกหรอแบบ โถลในระบบชั้นเคลือบแบบสลับของวัสดุนิกเกิลและทองแดง บนชิ้นงานเหล็กเกรด 52100 การสลับกันของชั้นเคลือบนิกเกิลทองแดงที่ความหนาเท่ากัน พบว่ามีค่าความต้านทานการสึกหรอ ที่ดีกว่าวัสดุนิกเกิลหรือทองแดง วัสดุนิกเกิลมีการสึกหรอน้อยกว่าวัสดุทองแดงสองเท่า และระบบที่มี การสลับนิกเกิลทองแดงจะมีค่าการสึกหรอน้อยที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 2.16



ภาพที่ 2. 16 ปริมาตรการสึกหรอต่อหน่วยระยะไถลของชั้นเคลือบวัสดุคอมโพสิทนิกเกิลทองแดง โลหะนิกเกิล และโลหะทองแดง [25]

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2004 F. Hu, K.C. Chan [28] ศึกษาผลของความหนาแน่นกระแสที่ใช้ในการชุบ เคลือบโลหะนิกเกิลลงบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีการชุบแบบใช้ไฟฟ้า ที่มีการใช้อนุภาคซิลิกอน คาร์ไบด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 นาโนเมตร ซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิกส์ที่มีค่าความแข็งสูง เพื่อทำให้ชั้นเคลือบกลายเป็นวัสดุคอมโพสิทที่มีอนุภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์กระจายตัวอยู่ในเนื้อพื้น นิกเกิล พบว่าผลของความหนาแน่นกระแสที่ใช้ในการชุบเคลือบส่งผลต่อโครงสร้างของชั้นเคลือบ คือ การใช้ความหนาแน่นกระแสที่สูงจะทำให้ได้โครงสร้างที่มีลักษณะเกรนที่เล็กกว่าการใช้ความ หนาแน่นกระแสต่ำ ดังแสดงในภาพที่ 2.17

**UHULALONGKORN UNIVERSITY** 



ภาพที่ 2. 17 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากเทคนิค SEM ของชั้นเคลือบโลหะเนื้อพื้นนิกเกิลและ อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ผลิตโดยวิธีชุบไฟฟ้าที่ความหนาแน่นกระแส ก) 2 A•dm<sup>-2</sup>, ข) 3 A• dm<sup>-2</sup>, ค) 4 A•dm<sup>-2</sup> [28]

# Chulalongkorn University

ผลกระทบจากค่าความหนาแน่นกระแสที่มีต่อขนาดเกรนของชั้นเคลือบส่งผลโดยตรงต่อค่า ความแข็งผิวตามความสัมพันธ์ของ Hall-Petch และผลของการนำอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์มาทำให้ ชั้นเคลือบกลายเป็นวัสดุคอมโพสิททำให้ชั้นเคลือบมีค่าความแข็งผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบ กับชั้นเคลือบนิกเกิลที่ไม่มีการใช้อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ ดังแสดงในภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2. 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวและความหนาแน่นกระแสที่ใช้ใน วัสดุนิกเกิล และนิกเกิลที่มีการเติมอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ [28]

และในปี 2010 Timothy J. Rupert และ Christopher A. Schuh [4] ได้ทำการทดสอบ เกี่ยวกับสมบัติความต้านทานการสึกหรอของวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน ที่ได้จากการชุบเคลือบ แบบใช้ไฟฟ้ากระแสช่วงสลับ โดยควบคุมปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบโดยการปรับค่ากระแส ช่วงสลับ และทำการทดสอบการสึกหรอแบบไถลโดยวิธี pin-on-disk ได้ความสัมพันธ์ดังตารางที่ 2.3

W content (at.%)	Average XRD grain size (nm)	Average TEM grain size (nm)	Hardness (GPa)	Wear volume (µm <sup>3</sup> )	Friction coefficient
3.0	47		4.0	$9.49 \times 10^{6}$	0.63
6.0	30		5.6	$7.40 \times 10^{6}$	0.67
8.2	26	25	5.9	$5.88 \times 10^{6}$	0.61
12.5	15		6.6	$5.12 \times 10^{6}$	0.65
15.7	9		6.8	$5.06 \times 10^{6}$	0.66
18.2	6	6	6.9	$4.03 \times 10^{6}$	0.65
22.9	5		7.1	$3.79 \times 10^{6}$	0.60
27.9	3	3	7.1	$2.77 \times 10^{6}$	0.66

ตารางที่ 2. 3 ปริมาณธาตุทั้งสเตน ขนาดเกรน และสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะผสมนิกเกิล ทั้งสเตนที่ได้จากการชุบไฟฟ้า [4]

จากผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและค่าความแข็งผิว สามารถ อธิบายได้ดังสมการของ Archard ดังนี้



และจากผลการทดลองจริง พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและค่าความ แข็งผิว เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการที่ 2.4 พบว่ามีความแตกต่าง ในบางช่วง ดังแสดงในภาพที่ 2.19



## ภาพที่ 2. 19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและค่าความแข็งผิวของ วัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน [4]

ภายหลังได้มีการวิเคราะห์ถึงกลไกที่ทำให้ค่าที่ได้จากการทดลองเบี่ยงเบนไปจาก ความสัมพันธ์ดังสมการที่ 2.4 พบว่า ในระหว่างการทดสอบการสึกหรอมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้น จากการเสียดสีของวัสดุ เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของเกรน และนอกจากนั้นยังพบว่าความเครียดที่ เกิดขึ้นทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากกลไกการเพิ่มความแกร่งในงาน (work hardening) ส่งผลทำให้วัสดุมีค่าความแข็งผิวเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุทำให้การสึกหรอของ วัสดุไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์ของสมการที่ 2.4 ความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการทดสอบการสึก หรอดังแสดงในภาพที่ 2.20



ภาพที่ 2. 20 กราฟแสดงผลของค่าความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการทดสอบการสึกหรอ [4]

ในปี 2010 Amnuaysak Chianpairot และคณะ [10] ได้ทำการชุบเคลือบโลหะนิกเกิลและ โลหะผสมนิกเกิลทังสเตนผลึกนาโน โดยการชุบไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า reverse pulse เพื่อศึกษา พฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อน โดยการใช้ส่วนประกอบในอ่างเคลือบของโลหะผสมนิกเกิล ทังสเตน ดังแสดงในตารางที่ 2.4 ชุบเคลือบที่สภาวะอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ควบคุมปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบและขนาดเกรนจากการควบคุมค่าความหนาแน่นกระแส reverse pulse โดยใช้ความหนาแน่นกระแส forward 0.20 A/cm<sup>2</sup> และจะมีการปรับค่าความ หนาแน่นกระแส reverse pulse ที่ 0, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.30 A/cm<sup>2</sup> ใช้ forward pulse time และ reverse pulse time คือ 20 และ 3 ms ตามลำดับ และได้ผลการทดลองดังแสดงใน ตารางที่ 2.5

ตารางที่	2. 4	สารเคมีแล	ะปริมาถ	เที่ใช้ในกา	ารเตรียมส	ารละลา	ยอิเล็คโ	ตรไลต์สำ	เหรับการ	เชุบเคลือบ
โลหะผส	มนิกเ	เกิลทั้งสเตน	[10]							

ชื่อสารเคมี	สูตรเคมี	ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)
Sodium citrate dihydrate	Na <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>7</sub> •2H <sub>2</sub> O	147
Ammonium chloride	NH₄Cl	26.7
Nickel sulfate hexahydrate	NiSO <sub>4</sub> •6H <sub>2</sub> O	15.8
Sodium tungstate dihydrate	Na <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> •2H <sub>2</sub> O	46.2
Sodium bromide	NaBr	15.5

Sample	Reverse pulse current (A/cm <sup>2</sup> )	Tungsten content (at.%)	Average grain size (nm)
mc Ni	0	0	7 µm
Ni-5 W	0.30	4.9	63
Ni-6 W	0.20	6.0	39
Ni-11 W	0.15	10.7	10
Ni-18 W	0.10	17.8	6
Ni-22 W	0	21.8	5

ตารางที่ 2. 5 การจ่ายค่ากระแส reverse pulse ปริมาณธาตุทั้งสเตน และขนาดเกรน ของโลหะ ผสมนิกเกิลทั้งสเตน [10]

การลดลงของค่าความหนาแน่นกระแส reverse pulse ส่งผลทำให้ปริมาณทั้งสเตนในชั้น เคลือบโลหะผสมเพิ่มสูงขึ้น สนับสนุนการเกิดเกรนที่เล็กจากการแยกตัวผ่านขอบเกรนของทั้งสเตนใน เนื้อพื้นนิกเกิล ทำให้สามารถที่จะทำนายและควบคุมปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบและโครงสร้าง จุลภาค จากการปรับค่าตัวแปรความหนาแน่นกระแส reverse pulse ดังแสดงในภาพที่ 2.21



ภาพที่ 2. 21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสย้อนกลับ, ปริมาณทั้งสเตน และขนาดเกรน ของวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน [10]

และในปี 2011 มีงานวิจัยของ Narasak Sunwang และคณะ [3] ได้ทำการศึกษาผลกระทบ ของการอบอ่อนที่มีต่อค่าความแข็งผิวและความต้านทานการสึกหรอของผิวเคลือบวัสดุโลหะผสม นิกเกิลทังสเตนเพื่อใช้ในงานที่อุณหภูมิสูง ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการผลิต และโครงสร้าง จุลภาค ที่ได้จากการชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้ากระแสแบบช่วงสลับ โดยที่สามารถที่จะควบคุมปริมาณ ของทังสเตน และขนาดเกรนในชั้นเคลือบได้ จาก reverse pulse time ที่ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 2.6

Reverse pulse duration (ms)	Ni (at.%)	W (at.%)	Grain size (nm)
1	78	22	3
6	87	13	13
9	94	6	56

ตารางที่ 2. 6 ค่าช่วง reverse pulse ปริมาณส่วนประกอบทางเคมี และขนาดเกรน ของชั้น เคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน [3]

จะเห็นได้ว่าชั้นเคลือบที่มีปริมาณทั้งสเตนสูงสุดในการทดลองนี้คือ Ni–22W ซึ่งเป็นผลมา จากการใช้ช่วงเวลากระแสย้อนกลับน้อยสุด จะมีขนาดเกรนเล็กสุดคือ 3 นาโนเมตร ส่งผลทำให้มีค่า ความแข็งผิวที่สูงสุด สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของ Hall-Petch จึงได้มีการนำชั้นเคลือบ Ni-22W ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการอบอ่อน (annealing) ที่อุณหภูมิ 700, 900 และ 1100 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะเพิ่มค่าความแข็งผิว และนำไปทดสอบหาค่าสมบัติเชิงกลในด้านความแข็งผิวโดยเทคนิคไม โครวิกเกอร์ และการสึกหรอแบบไถลโดยเทคนิค ball-on-disc ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2.7 ซึ่งพบว่ากระบวนการอบอ่อน ทำให้ค่าความแข็งผิวเพิ่มขึ้นจากกระบวนการการจัดเรียงตัวใหม่ ของผลึก (grain relaxation) เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการอบอ่อน แต่จะทำให้เกิดการ โตของเกรน (grain growth) ส่งผลให้การสึกหรอเกิดมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าการอบอ่อนที่ 700 องศาเซลเซียสจะให้ค่าความแข็งผิวที่สูงที่สุดคือ 10.5 GPa และมีค่าการสึกหรอเพิ่มขึ้นจาก 1.6×10<sup>6</sup> µm<sup>3</sup> ไปเป็น 12.7×10<sup>6</sup> µm<sup>3</sup> เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการอบอ่อน

ตารางที่ 2. 7 ค่าขนาดเกรน และสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน Ni–22%W ที่ผ่านการอบอ่อนเป็นเวลา 30 นาที [3]

Heat treatment temperature (°C)	Grian size (nm)	Hardness (GPa)	Wear loss $(\times 10^6 \mu\text{m}^3)$
As-plated	3	7	1.6
700	44	10.5	12.7
900	50	9.5	31.1
1100	70	7.5	126.3

ต่อมาได้มีการนำชั้นเคลือบ Ni-22W ที่ผ่านการทดสอบการสึกหรอ นำมาวัดหาค่าความแข็ง ผิวอีกครั้งที่บริเวณรอยการสึกหรอที่เกิดขึ้น พบว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการอบอ่อนมีค่าความแข็งผิวที่ เพิ่มขึ้นบริเวณรอยการสึกหรอ ซึ่งเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นในระหว่างการสึกหรอจากการเสียดสี ส่งผลให้กลไกที่เกิดขึ้นคือการจัดเรียงตัวใหม่ของผลึก ทำให้มีค่าความแข็งผิวเพิ่มสูงขึ้นจากชิ้นงาน ก่อนทำการทดสอบการสึกหรอ ดังแสดงในภาพที่ 2.22



ภาพที่ 2. 22 กราฟแสดงการเปรียบเทียบของค่าความแข็งผิวของชิ้นงาน Ni-22W ที่ผ่านการอบ อ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในบริเวณที่ไม่มีการสึกหรอ และบริเวณรอยการสึกหรอ [3]

แนวทางการชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่น่าสนใจจากงานวิจัยของ V.D. Papachristos และ คณะในปี 1998 [18] ได้ทำการศึกษาการประพฤติตัวของการสึกหรอของวัสดุโลหะผสมนิกเกิล ฟอสฟอรัสทังสเตน (Ni-P-W) โครงสร้างอสัณฐาน (amorphous) ที่ได้การชุบเคลือบแบบใช้ไฟฟ้า ลงบน pin steel โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบ นั่นคือ ปริมาณทังสเตนในชั้น เคลือบจากการชุบเคลือบแบบสลับหลายชั้น ที่มีการสลับชั้นที่มีปริมาณทังสเตนต่ำ (Ni-10P-10W) สลับกับชั้นที่มีปริมาณทังสเตนสูง (Ni-5P-45W) โดยใช้อ่างชุบเคลือบเดี่ยวที่ควบคุมปริมาณของ ทังสเตนโดยการใช้กระแสแบบช่วงสลับ ในรูปแบบของคลื่น

ชั้นผิวเคลือบที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำ ได้จากการชุบเคลือบในช่วงความหนาแน่นกระแสต่ำ ชั้นผิวเคลือบที่มีปริมาณทั้งสเตนสูง ได้จากการชุบเคลือบในช่วงความหนาแน่นกระแสสูง โดยการชุบ เคลือบของชั้นที่สลับติดกันรวมเรียกกว่าไบเลเยอร์ จะมีค่า 6, 20, 60, 200, 600, 2000 นาโน-เมตร โดยชั้นเคลือบจะมีความหนารวมประมาณ 25 ไมครอน

จากการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของจำนวนชั้นเคลือบที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน พบว่าจำนวนชั้นเคลือบไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดังแสดงในรูปที่ 2.23



ภาพที่ 2. 23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและแรงกดของชั้นเคลือบหลาย ชั้นที่มีจำนวนชั้นแตกต่างกัน [18]



ภาพที่ 2. 24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอและแรงกดของชั้นเคลือบหลายชั้นที่มี จำนวนชั้นแตกต่างกัน [18]

จากภาพที่ 2.24 แสดงให้เห็นถึงผลของการทำการชุบเคลือบแบบหลายชั้น ที่มีต่อค่าการสึก หรอของวัสดุ Ni-P-W เมื่อมีแรงกดเพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีปริมาณของเนื้อวัสดุที่ถูกสึกหรอเพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของความหนาแต่ละชั้นเคลือบพบว่า เมื่อชั้นเคลือบบางหลายชั้น จำนวนมากจะส่งผลทำให้มีปริมาณของเนื้อวัสดุสึกหรอลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละชั้นเคลือบของวัสดุ Ni-P-W ประพฤติตัวเป็นวัสดุแบบ เปราะ เนื่องจากโครงสร้างแทบจะเป็นวัสดุอสัณฐาน ดังนั้นกลไกการสึกหรอในงานวิจัยนี้ไม่เกี่ยวข้อง กับการแปรรูปแบบถาวร (plastic deformation) การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น การที่มีชั้นเคลือบ บางหลายชั้นจำนวนมาก ทำให้มีการสะสมของจำนวนพื้นที่ผิวสัมผัส ส่งผลทำให้รอยแตกมีการโตได้ ยาก ต้องใช้พลังงานสูงในการที่จะทำให้รอยแตกโต วัสดุจึงมีค่าความแกร่งเพิ่มขึ้นจากการที่มีจำนวน ชั้นเคลือบเพิ่มมากขึ้นเมื่อความหนารวมคงที่

ต่อมาในปี 1999 V.D. Papachristos และคณะ [17] ได้ทำการศึกษาทดลองเพิ่มเติมศึกษา การชุบเคลือบวัสดุ Ni-P-W แบบหลายชั้นลงบนแผ่นทองแดงโดยวิธีชุบไฟฟ้าที่ใช้กระแสแบบช่วง ชั้นเคลือบประกอบไปด้วยชั้นที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำ(Ni-10P-10W) สลับกับชั้นที่มีปริมาณทั้งสเตนสูง (Ni-5P-45W) โดยสนใจที่ผลกระทบของการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200-800 องศาเซลเซียส เพื่อหา ผลกระทบของการเกิดการตกผลึกใหม่ และนำไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้น โดยชั้นเคลือบ ที่ได้จะมีโครงสร้างแบบหลายชั้นดังแสดงในภาพที่ 2.25



## ภาพที่ 2. 25 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากเทคนิค TEM มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ของชั้นเคลือบอสัณฐาน Ni-P-W [17]

โครงสร้างที่ได้จาก TEM แสดงให้เห็นเป็นลักษณะหลายชั้น ของชั้นเคลือบอสัณฐาน โดยที่ ชั้นสีเข้มจะแสดงถึงชั้นเคลือบที่มีปริมาณทังสเตนสูง และชั้นสีอ่อนจะแสดงชั้นเคลือบที่มีปริมาณ ทั้งสเตนต่ำ และมีการพบเห็นผลึกขนาดเล็กเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นเคลือบช่วงที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำ และจากผลการทดลองของงานวิจัยนี้ กลไกการตกผลึกในระหว่างการอบอ่อนจะเกิดขึ้นในช่วง 300 และไปสิ้นสุดที่ 600 องศาเซลเซียส

การนำไปผ่านการอบอ่อน จะทำให้ได้ค่าความแข็งพื้นผิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลไกการเกิดการ ตกผลึกใหม่ของชั้นผิวโครงสร้างอสัณฐานกลายเป็นโครงสร้างผลึกระดับนาโนรวมกับโครงสร้าง อสัณฐาน ประกอบไปด้วยสารละลายของแข็งของนิกเกิลทังสเตนที่มีโครงสร้างผลึก fcc และ สารประกอบโลหะ Ni<sub>3</sub>P ที่มีโครงสร้างผลึก bcc ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของความแข็งพื้นผิว



## ภาพที่ 2. 26 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งพื้นผิวกับอุณหภูมิการอบอ่อนของวัสดุที่ผ่านการ ชุบเคลือบแบบหลายชั้น [17]

จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการอบอ่อนจะมีแนวโน้มที่ทำให้ค่าความแข็งพื้นผิวเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากกลไกการตกผลึก แต่ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดกลไกการโตของผลึกซึ่งจะทำให้ค่า ความแข็งผิวลดลง ดังรูปที่ 2.26 โดยที่การเกิดผลึกจะเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณที่มีทังสเตนต่ำก่อน เนื่องจากทังสเตนมีส่วนช่วยในการเพิ่มความเสถียรทางความร้อนของชั้นเคลือบ ในปี 2001 V.D. Papachristos และคณะ [15] ได้ทำการศึกษาถึงค่ามอดูลัส ความแข็ง พื้นผิว ของชั้นเคลือบ Ni-P-W แบบหลายชั้นที่ได้จากการชุบไฟฟ้าโดยใช้กระแสแบบช่วง ในรูปแบบ คลื่น ที่ประกอบด้วยช่วง ชั้นเคลือบประกอบไปด้วยชั้นที่มีปริมาณทังสเตนต่ำ(Ni-10P-10W) สลับกับชั้นที่มีปริมาณทังสเตนสูง (Ni-5P-45W) ที่มีความหนาและจำนวนชั้นเคลือบแตกต่างกัน โดยการปรับค่าความยาวคลื่นในการเคลือบ และมีการใช้ acoustic resonance method ในการวัด ค่ามอดูลัสดังได้ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 2.27 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ของค่าความยาวคลื่นและ ค่ายังมอดูลัส แต่ค่ามอดูลัสของชั้นเคลือบ Ni-P-W แบบหลายชั้นที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นเคลือบ โลหะนิกเกิล พบว่ามีค่ามอดูลัสมากกว่าชั้นเคลือบนิกเกิล 1 0 . 4 เปอร์เซ็นต์





กระชาวสาวแต่งการกามเซ็ามีการกิจแลกร์ พบก่อว่าการกามซึ่งสั้น

จากการทดสอบค่าความแข็งผิวโดยไมโครวิกเกอร์ พบว่าค่าความแข็งพื้นผิวจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความหนาของแต่ละชั้นเคลือบลดลง ดังแสดงในภาพที่ 2.28 โดยที่การความแข็งพื้นผิว ของ วัสดุอสัณฐานมีแนวโน้มเดียวกับวัสดุมีผลึก ค่าความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายได้คือ โดยทั่วไป วัสดุอสัณฐานจะมีเลขโคออดิเนชั่น น้อยกว่าวัสดุที่มีผลึก ทำให้ค่าปริมาณอะตอมมีความ ไม่ สม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาปริมาตรว่าง (free volume) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นตำหนิ จะเป็นบริเวณที่มี การสะสมของพลังงาน และความเค้นสะสม การที่ความยาวคลื่นในการเคลือบมาก ทำให้มีปริมาตร ว่างมาก จึงส่งผลทำให้มีค่าความแข็งพื้นผิวต่ำ อีกทั้งการที่ความยาวคลื่นในการเคลือบน้อยเป็นการ ส่งเสริมการต้านการแปรรูปแบบถาวร



ภาพที่ 2. 28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งพื้นผิวและค่าความหนาของชั้นเคลือบย่อยที่อยู่ ติดกันของวัสดุ Ni-P-W [15]

ในปี 2011 J. Lamovec และคณะ [19]ได้ทำการศึกษาการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของชั้น เคลือบคอมโพสิทวัสดุนิกเกิลและทองแดง ลงบนชิ้นงานแผ่นทองแดง โดยสนใจที่ค่าความหนาของผิว แต่ละชั้นเคลือบ ค่าความหนารวม และสัดส่วนความหนาที่มีการสลับของชั้นเคลือบวัสดุคอมโพสิท ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งผิว

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและสัดส่วนความหนาของชั้น เคลือบ โดยที่วัสดุนิกเกิลมีค่าความแข็งผิวประมาณ 1 GPa และวัสดุทองแดงมีค่าความแข็งผิว ประมาณ 0.5 GPa พบว่าชั้นเคลือบที่มีสัดส่วนความหนาชั้นเคลือบนิกเกิลมาก จะทำให้มีค่าความ แข็งผิวคอมโพสิทมาก และชั้นเคลือบที่มีสัดส่วนความหนาชั้นเคลือบทองแดงมาก จะทำให้ค่าความ แข็งผิวคอมโพสิทลดลง ดังแสดงในภาพที่ 2.29 และ 2.30



ภาพที่ 2. 29 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและความลึกรอยกด ที่ สัดส่วนความหนาของชั้นเคลือบนิกเกิลมากกว่าทองแดง [19]



ภาพที่ 2. 30 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวชั้นเคลือบคอมโพสิทและความลึกรอยกด ที่ สัดส่วนความหนาของชั้นเคลือบทองแดงมากกว่านิกเกิล [19]

และเมื่อพิจารณาจากความหนารวมของชั้นเคลือบคอมโพสิท และความหนาของแต่ละชั้น เคลือบที่มีสัดส่วนปริมาณนิกเกิลหรือทองแดงเท่ากัน พบว่าที่ความหนารวมเท่ากันชั้นเคลือบที่มี ความบางจะส่งเสริมค่าความแข็งผิวคอมโพสิท และที่ความหนาชั้นเคลือบเท่ากัน ชิ้นงานที่มีความ หนารวมมากจะทำให้มีค่าความแข็งผิวคอมโพสิทมาก ดังแสดงในภาพที่ 2.31





ผลของชั้นเคลือบแบบคอมโพสิทหลายชั้นสามารถเพิ่มค่าความแข็งของผิวเคลือบได้ 2 เท่า ของค่าความแข็งผิววัสดุนิกเกิล เนื่องจากการที่มีโครงสร้างแบบหลายชั้นทำให้มีจำนวนรอยต่อ ระหว่างแต่ละชั้นเคลือบมาก สามารถต่อต้านการเกิดการแปรรูปถาวรได้

ในปี 2011 Yi Kong และ Luming Shen [29] [29] ได้ทำการศึกษาถึงกลไกที่ช่วยเพิ่มความ แข็งแรงให้กับโครงสร้างการซุบเคลือบแบบหลายชั้น ที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยอยู่ในระดับนา โน โดยได้ทำการศึกษาถึงการทำให้ได้โครงสร้างแบบหลายชั้นของวัสดุโล หะต่างชนิดกันใน หลากหลายระบบ ซึ่งสามารถที่จะทำให้ได้ลักษณะของรอยต่อของชั้นเคลือบที่แตกต่างกันออกไป โดยจะสนใจที่ระบบของรอยต่อ คือ รอยต่อแบบมีความเข้ากันได้ (coherent interface) ที่เกิดจาก การมีชนิดโครงสร้างผลึกเหมือนกัน เช่น fcc/fcc ของวัสดุ Cu-Ni และรอยต่อที่ไม่เข้ากัน (incoherent interface) ที่เกิดจากการมีชนิดโครงสร้างผลึกที่ต่างกัน เช่น fcc/bcc ของวัสดุ Cu-Nb, Al-Nb เป็นต้น โดยมีความสัมพันธ์ของค่าความแข็งผิวและความหนาของชั้นเคลือบย่อยใน ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุในระบบต่าง ๆ ดังแสดงในภาพ 2.32



ภาพที่ 2. 32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งผิวและความหนาของชั้นเคลือบย่อยใน ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุในระบบต่าง ๆ [29]

ONDEALONGKONN ONIVERSITI

กลไกที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น หลัก ๆ จะเกี่ยวข้องกับ

- 1. แบบจำลองการข้ามดิสโลเคชั่นแบบ Hall-Petch
- 2. ความแข็งที่เพิ่มจากการมีค่าโมดูลัสที่แตกต่างกัน
- 3. การเพิ่มความแข็งแรงแบบ Orowan
- 4. การเพิ่มความแข็งแรงจากการมีความเค้นที่เข้ากันได้
- 5. การเพิ่มความแข็งแรงจากการขัดขวางของโครงสร้าง

- 6. การไถลที่ถูกกักขังภายในชั้นเคลือบ
- 7. การเพิ่มความแข็งแรงจากสารละลายของแข็ง

ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างแบบหลายชั้นยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่แน่นอนได้ แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นมาจากการรวมกันของกลไกที่แตกต่างกันเหล่านี้ และมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมากมายภายในโครงสร้างหนึ่งระบบ

ในปี 2010 J. Wang และ A. Misra [30] ได้ทำการศึกษาภาพรวมของอิทธิพลของรอยต่อชั้น เคลือบในโครงสร้างแบบหลายชั้นในวัสดุโลหะ ที่มีโครงสร้างของรอยต่อแบบไม่เข้ากันของโครงสร้าง fcc/bcc พบว่า ความแข็งแรงของโครงสร้างแบบหลายชั้นในวัสดุโลหะจะมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลดลง ของความหนาชั้นเคลือบย่อย ตามกระบวนการย่อยดังแสดงในแบบจำลองภาพที่ 2.33



ภาพที่ 2. 33 แบบจำลองแสดงกระบวนการย่อยในการหากลไกที่ได้รับในวัสดุโลหะโครงสร้าง หลายชั้น

## บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

### 3.1 เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานวิจัย

การศึกษางานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเริ่มตั้งแต่การเตรียมชิ้นงาน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีต่าง ๆ สำหรับเตรียมผิวชิ้นงาน การชุบเคลือบผิวทั้งแบบใช้ไฟฟ้า การทดสอบ ความต้านทานการสึกหรอ การทดสอบค่าความแข็งผิว ตลอดจนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคหรือ เฟสต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นดังนี้

### 3.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมผิวชิ้นงาน

- แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430
- กระดาษทรายเบอร์ 180, 240, 800, 1200, 2500 และผ้าสักหลาด
- ผงเพชรขนาด 3 และ 1 ไมครอน
- เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างความเร็วต่ำ (Low speed cutting Machine)
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 10%wt
- กรดไฮโดรคลอริก (HCI) ความเข้มข้น 14%wt
- กรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ความเข้มข้น 10% vol
- เครื่องขัดผิวชิ้นงาน
- เครื่องอัลตร้าโซนิก

### 3.1.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้สำหรับการชุบเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้า ได้แก่

- เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสช่วงสลับ
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิสารละลายอิเล็คโตรไลต์
- แผ่นตะแกรงแพลทินัม
- สารละลายอิเล็กโตรไลต์นิกเกิลสไตร์ค

### 3.1.3 เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและทดสอบวัสดุ

- สารละลายอิเล็กโตรไลต์โลหะผสมนิกเกิล-ทังสเตน
- กล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope, OM) ใช้ศึกษาความหนาของชั้นเคลือบและ โครงสร้างจุลภาคเบื้องต้นของชั้นเคลือบ

- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
  ใช้ศึกษา ขนาดของเกรน รวมทั้งลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบที่เกิดขึ้นภายหลัง การชุบเคลือบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy dispersive spectroscopy, EDS) ใช้ตรวจสอบ
  ชนิดและปริมาณส่วนประกอบทางเคมีแต่ธาตุของเฟสภายในโครงสร้างจุลภาค เพื่อใช้
  วิเคราะห์ชนิดของสารประกอบและปริมาณธาตุผสม
- เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของธาตุ (Electron Probe Micro Analysis , EPMA) ใช้ศึกษาการกระจายตัวของธาตุแต่ละชนิดในโครงสร้างจุลภาคของภาคตัดขวางชั้น เคลือบ
- เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer, XRD) เพื่อตรวจสอบหาชนิด ของสารประกอบที่เกิดขึ้นภายในชั้นเคลือบ
- เครื่องวัดความแข็ง (Microvicker hardness tester) ใช้ทดสอบความแข็งผิวของชั้นเคลือบ
  โดยใช้หัวกดเพชรรูปทรงพิรามิดขนาดเล็ก
- เครื่องทดสอบความต้านทานการสึกหรอแบบไถลชนิด Ball-on-disc เพื่อใช้ทดสอบหาการสึก หรอแบบไถลของชั้นเคลือบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว Profilometer ใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ภาคตัดขวางของ ร่องการสึกหรอที่เกิดขึ้น โดยการใช้หัวเข็ม (stylus) ลากผ่านบริเวณที่ทำการทดสอบการสึก หรอ และทำการหาขนาดของร่องการสึกหรอที่เกิดขึ้น

### 3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย

### 3.2.1 การเตรียมผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430

ตัดขึ้นงานแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมให้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร จากนั้น บัดกรีแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเข้ากับสายไฟทองแดง และนำไปหล่อเรซิ่นปิดทับผิวขึ้นงานด้านที่มีการ บัดกรียึดติดกับสายไฟทองแดง เพื่อเป็นการทำให้เกิดการซุบเคลือบที่บริเวณด้านเดียวของแผ่นขิ้นงาน โดยที่ก่อนทำการซุบเคลือบผิววัสดุพื้นต้องผ่านขั้นตอนการขัดผิวขิ้นงานให้มีความเรียบและทำความ สะอาดผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก โดยการขัดผิวขึ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 ตามด้วยเบอร์ 240 จากนั้น นำแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมไปแซ่ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10%wt ที่อุณหภูมิ 60 องศา-เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างด่างออกด้วยน้ำกลั่น หลังจากนั้นนำไปแซ่ในกรดไฮโดรคลอริก 14%wt ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างกรดออกด้วยน้ำกลั่น ต่อจากนั้นนำไปซุบเคลือบ ผิวด้วยนิกเกิลสไตร์ค

#### 3.2.2 การชุบเคลือบผิวด้วยนิกเกิลสไตร์ค

เตรียมสารละลายอิเล็กโตรไลต์นิกเกิลสไตร์ค ชนิดซัลเฟต โดยมีส่วนผสมดังนี้

- น้ำกลั่น
- นิกเกิลซัลเฟต (NiSO<sub>4</sub>•6H<sub>2</sub>O) 250 กรัม/ลิตร
- กรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 25 มิลลิลิตร/ลิตร

ในการซุบนิกเกิลสไตร์คจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 0.16 แอมป์/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมิใน อ่างเคลือบ 40 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลาในการซุบ 10 นาที โดยที่หลังจากชุบเคลือบผิวด้วย นิกเกิลสไตร์คเสร็จแล้ว ใช้น้ำกลั่นล้างชิ้นงานให้สะอาด และกระตุ้นผิวโดยการจุ่มลงในสารละลายกรด กำมะถัน 10wt% เป็นเวลา 10 วินาที จึงทำการทดลองในขั้นตอนต่อไป

### 3.2.3 การชุบเคลือบผิวโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนแบบใช้ไฟฟ้ากระแส reverse pulse

เตรียมสารละลายอิเล็คโตรไลต์นิกเกิล-ทังสเตน โดยการเตรียมบีกเกอร์ที่ใส่น้ำกลั่น ปริมาตร 400 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส และกวนสารละลายตลอดเวลา โดยใช้ แท่งแม่เหล็ก และเติมสารเคมีดังตารางที่ 3.1 โดยการเติมต้องรอให้สารเคมีก่อนหน้าละลาย หมดก่อน จึงค่อยเติมตัวต่อไปได้ เพื่อให้สารเคมีละลายได้อย่างสมบูรณ์ และมีการตั้งค่าเครื่องจ่าย กระแสแบบช่วงสลับแบ่งออกเป็น 4 ชุดดังแสดงในภาพที่ 3.1

สารเคมี	สูตรเคมี	ปริมาณ (กรัมต่อลิตร)
Sodium citrate dihydrate	Na <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>7</sub> •2H <sub>2</sub> O	147
Ammonium chloride	NH₄Cl	26.7
Nickel sulfate hexahydrate	NiSO <sub>4</sub> •6H <sub>2</sub> O	15.8
Sodium tungstate dihydrate	Na <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> • 2H <sub>2</sub> O	46.2
Sodium bromide	NaBr	15.5

ตารางที่ 3. 1 แสดงสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสารละลายอิเล็คโตรไลต์นิกเกิลทังสเตน



ภาพที่ 3. 1 รูปแบบการชุบเคลือบแบบช่วงสลับ โดยมีการปรับค่ากระแสช่วงกลับเพื่อให้ได้ ส่วนประกอบทางเคมีต่าง ๆ

ทำการชุบเคลือบโดยใช้สภาวะความหนาแน่นกระแส forward ที่ 0.2 แอมแปร์ต่อตาราง เซนติเมตร และใช้ความหนาแน่นกระแส reverse pulse ที่ 0, 0.15, 0.30 แอมแปร์ต่อตาราง เซนติเมตร โดยใช้ forward pulse timeและ reverse pulse time คือ 20 และ 3 มิลลิวินาที ตามลำดับ ทั้งนี้ ต้องมีการนำค่าความหนาแน่นกระแสที่กำหนดมาคำนวณกับขนาดพื้นที่จริงก่อนทำ การชุบเคลือบด้วย และสำหรับการชุบเคลือบแบบหลายชั้น นำรูปแบบลักษณะการจ่ายกระแสไฟ ตามภาพที่ 3.1 มาใช้ในการออกแบบโดยการเรียงสลับกัน เช่น การชุบเคลือบแบบหลายชั้น A สลับ C ดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3. 2 แบบจำลองลักษณะการสลับรูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า A สลับ C

### <u>โดยการทดลองในตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ</u>

# 3.2.3.1 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของจำนวนชั้นเคลือบที่แตกต่างกัน โดยมีความหนารวมคงที่

โดยจะใช้การซุบเคลือบสลับชั้นในรูปแบบ A และ C ที่มีการตั้งค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าดัง แสดงในรูปที่ 3.2 และจะมีการตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาในการซุบเคลือบในแต่ละรูปแบบเพื่อสลับชั้นกัน เพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อยที่แตกต่างกัน คือ 25, 50 , 250, 500, 2500 และ 5000 นาโนเมตร และมีการควบคุมระยะเวลาในการซุบเคลือบรวมที่ 60 นาที เพื่อให้ชิ้นงานทั้งหมด มีความหนารวมอยู่ในระดับเดียวกัน โดยมีตัวอย่างลักษณะการจำลองของชั้นเคลือบ ดังแสดงภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3. 3 การจำลองชั้นเคลือบที่มีความหนารวมเท่ากันแต่มีจำนวนชั้นเคลือบแตกต่างกัน

# 3.2.3.2 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของความหนารวมของชั้นเคลือบ ที่แตกต่างกัน

ทำการชุบเคลือบสลับชั้นในรูปแบบ A และ C ที่มีการตั้งค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าดังแสดง ในภาพที่ 3.1 และมีการใช้ระยะช่วงจังหวะเวลาในการสลับการชุบเคลือบในแต่ละชั้นคงที่เท่ากัน คือประมาณ 50 นาโนเมตร โดยจะมีการใช้ระยะเวลาในการชุบเคลือบทั้งหมดที่แตกต่างกันคือ 15, 30, 60 และ 90 นาที เพื่อให้ได้ความหนารวมของชั้นเคลือบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ได้ชั้นเคลือบที่ มีลักษณะแบบจำลองดังแสดงในภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3. 4 ภาพจำลองชั้นเคลือบที่มีความหนารวมแตกต่างกัน แต่มีความหนาแต่ละชั้นเคลือบ เท่ากัน

# 3.2.3.3 กรรมวิธีการชุบเคลือบผิวเพื่อหาผลกระทบของการสลับชั้นที่มีส่วนประกอบทาง เคมีที่แตกต่างกัน

โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มที่มีการสลับของรูปแบบในการชุบที่แตกต่างกันคือ A-B, A-C และ A-D โดยจะใช้ตัวแปรในการชุบเคลือบโดยการศึกษาที่ระดับความหนาขั้นเคลือบ ย่อย 50 นาโนเมตร และทำการชุบเคลือบเป็นเวลา 60 นาที ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการศึกษาสภาวะการ ชุบเคลือบมาก่อนหน้านี้ในหัวข้อ 3.2.3.1 และ 3.2.3.2 พบว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษา ทั้งนี้ชั้นเคลือบจะมีลักษณะดังแบบจำลองในภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3. 5 การจำลองชั้นเคลือบที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีในระบบที่แตกต่าง

# 3.3 การตรวจสอบชั้นเคลือบ

#### 3.3.1 การตรวจสอบและพิสูจน์โครงสร้างจุลภาค

หลังจากผ่านการซุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ชิ้นงานต้องผ่านการตรวจสอบขนาดของเกรน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด หาปริมาณธาตุผสมที่อยู่ในชั้นเคลือบด้วยเทคนิค EDS และวัดความหนาชั้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง โดยทำการตัดแบบขวางด้วยเครื่องตัด Low speed หล่อภายในเรซิ่น แล้วขัดผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 ถึง 2500 และขัดด้วยผ้าสักหลาด กับผงเพชรขนาด 3 ถึง 1 ไมครอน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบโครงสร้างของชั้นเคลือบโดยการ ตรวจวัดการกระจายตัวของธาตุโดยใช้เทคนิค EPMA เพื่อพิสูจน์ปริมาณการกระจายตัวของธาตุ ทังสเตนในโครงสร้างชั้นเคลือบแบบหลายชั้น

### 3.3.3 การตรวจสอบความแข็งผิว

หลังจากผ่านการชุบเคลือบผิวแบบ จะนำชิ้นงานทั้งหมดทดสอบความแข็งด้วยเครื่อง Microvicker hardness tester โดยตั้งค่าน้ำหนักกด (load) 50 กรัม และใช้เวลาในการกดวัดความ แข็ง 20 วินาที โดยแต่ละชิ้นงานจะทำการวัด 12 ครั้ง ซึ่งตำแหน่งของการวัดต้องห่างกันอย่างน้อย 2.5 เท่าของเส้นทแยงมุมของรอยกดเดิม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย

### 3.3.3 การตรวจสอบความต้านทานการสึกหรอ

นำมาทดสอบความต้านทานการสึกหรอด้วยเครื่อง Ball-on-disc ซึ่งบอลทำจากวัสดุ ทังสเตนคาร์ไบด์ โดยควบคุมน้ำหนักกด ความเร็ว ระยะทาง และทดสอบในสภาวะที่ไม่มี lubricant ซึ่งการทดสอบสามารถวัดค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน และน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ใช้แรงกด ในการทดสอบ 5 นิวตัน และนำไปทดสอบด้วยเครื่อง Profilometer เพื่อหาพื้นที่ภาคตัดขวางร่อง การสึกหรอ จากนั้นคำนวณปริมาณการสึกหรอ โดยการหาปริมาตรเนื้อวัสดุที่สูญเสียไป

**GHULALONGKORN UNIVERSITY** 

## บทที่ 4 ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง

## 4.1 การเตรียมผิวชิ้นงานและการชุบนิกเกิลสไตร์ค

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430 เป็นวัสดุพื้น จึงทำให้บริเวณผิวขิ้นงาน มีชั้นฟิล์มของโครเมียมออกไซด์ตามลักษณะของเหล็กกล้าไร้สนิมทำหน้าที่ในการป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งชั้นฟิล์มนี้เมื่อมีการสลายไปจะสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เองตลอดเวลา ตามลักษณะเฉพาะของ เหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งชั้นฟิล์มโครเมียมออกไซด์ทำให้การชุบเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องมีกระบวนการเตรียมผิวขึ้นงานโดยการชุบเคลือบนิกเกิลสไตร์คเป็นกรชุบไฟฟ้า โดยกระบวนการชุบนิกเกิลสไตร์ค จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การชุบนิกเกิลสไตร์คเป็นการชุบไฟฟ้า ในสภาวะสารละลายที่เป็นกรด ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดชั้นเคลือบของนิกเกิลบางที่ บริเวณผิวชิ้นงาน และสามารถสังเกตเห็นชั้นนิกเกิลสไตร์คได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่อง กวาดดังแสดงในภาพที่ 4.2

#### 4.2 การชุบไฟฟ้าโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน

### 4.2.1 การใช้กระแส reverse pulse ในการชุบไฟฟ้า

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปริมาณของโลหะที่เปลี่ยนแปลงตามการจ่ายค่ากระแสย้อนกลับ โดยทำการชุบเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนและมีการควบคุมการจ่ายค่ากระแสย้อนกลับ เพื่อที่จะให้ได้ชั้นเคลือบที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน อ้างอิงจากงานวิจัยของ Amnuaysak Chianpairot [10] รวมถึง Christopher A. Schuh[12] และ Detor Andrew J[31, 32]. ที่ได้ ทำการศึกษาสภาวะการชุบเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนโดยมีการจ่ายค่ากระแสย้อนกลับ

โดยได้เลือกการชุบเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนโดยวิธีการชุบไฟฟ้าที่มีการจ่าย ค่ากระแสช่วงสลับ 4 สภาวะ เพื่อให้ได้ชั้นเคลือบของโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนที่มีปริมาณค่าทั้งสเตน ในชั้นเคลือบแตกต่างกันจากน้อยไปมาก โดยให้เป็นชิ้นงาน A, B C และ D ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.1

ชิ้นงาน	Forward Pul ความหนาแน่น	.se เวลา	Reverse Pulse ความหนาแน่น เวลา		ส่วนประกอบ ทางเคมี (at% W)	ขนาดผลึก สัมพัทธ์ (nm)
	กระแส (Acm <sup>-</sup> )	(ms)	กระแส (Acm <sup>-</sup> )	(ms)		
A			0.30		6.3	51
В	0.20	20	0.15	3	8.7	41
С			0.00		13.8	27
D		0	0	0	29.4	5

ตารางที่ 4. 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่ากระแสช่วงสลับ, ปริมาณของธาตุทังสเตนในชั้น เคลือบ และขนาดผลึกสัมพัทธ์

ในรายงานวิจัยนี้จะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรเพื่อใช้ในการเป็นตัวแทนวัสดุที่มีส่วนประกอบทาง เคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งมาจากสภาวะการชุบเคลือบที่แตกต่างกันคือ วัสดุ A , วัสดุ B , วัสดุ C และ วัสดุ D ดังตารางที่ 4.1 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจำแนกและวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบการ ทดลองในขั้นต่อไป



ภาพที่ 4. 1 ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานภายหลังการชุบเคลือบโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตนผลึกนาโน ลงบนผิวชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม

โดยลักษณะชั้นเคลือบภายหลังการชุบไฟฟ้านิกเกิลทั้งสเตนจะมีลักษณะดังภาพที่ 4.1 และ จากผลการทดสอบหาโครงสร้างจุลภาคในภาคตัดขวางของชั้นเคลือบโดยใช้เทคนิค SEM ชิ้นงานที่ การชุบเคลือบนิกเกิลทั้งสเตนแบบแบบใช้ไฟฟ้าจะมีลักษณะภาคตัดขวางชั้นเคลือบดังแสดงในภาพที่ 4.2 ซึ่งจากภาพที่ได้จากเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด(SEM) จะสามารถสังเกตเห็นถึง ลักษณะของชั้นเคลือบนิกเกิลสไตร์คและนิกเกิลทั้งสเตน และมีความหนาของชั้นเคลือบนิกเกิล ทั้งสเตนประมาณ 40 ไมครอน เมื่อทำการชุบเคลือบระยะเวลา 60 นาที





ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุผสมในเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิค EDS ผลการ ทดลองที่ได้มีความสัมพันธ์ของการจ่ายค่ากระแส reverse pulse และปริมาณธาตุทังสเตนในชั้น เคลือบ คือ เมื่อมีการจ่ายค่ากระแส reverse pulse มากขึ้น จะส่งผลทำให้ชั้นเคลือบของวัสดุโลหะ ผสมนิกเกิลทังสเตนมีปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amnuaysak Chianpairot [10] รวมถึง Timothy J. Rupert [4]

ทั้งนี้ ปริมาณของทังสเตนในชั้นเคลือบที่ลดลงเกิดจาก โดยทั่วไปแล้ววิธีการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้าจะมีการต่อขั้วไฟฟ้าให้ชิ้นงานเป็นแคโทด และจะเกิดปฏิกิริยารีดักชั่น ดังแสดงในสมการที่ 4.1 โดยไอออนของโลหะที่อยู่ในสารละลายจะไปเกิดปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนที่มีอยู่บริเวณขั้วแคโทด ปฏิกิริยารีดักชั่นที่เกิดขึ้นคืออิออนโลหะรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารละลายของแข็งชุบ เคลือบที่บริเวณผิวชิ้นงานที่ต่ออยู่กับขั้วแคโทด แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่ากระแส reverse pulse จะเป็นการกลับขั้วทำให้ชิ้นงานมีสถานะเป็นชั้วแอโนด ดังนั้นในช่วงนี้ชิ้นงานจะเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชั่น ดังแสดงในสมการที่ 4.2 ซึ่งเป็นปฏิกิริยาของการสูญเสียอิเล็กตรอน ทำให้วัสดุมีการสูญเสียเนื้อ โลหะนิกเกิลและทังสเตนที่มาเคลือบ จากการกร่อนของปฏิกิริยา

ปฏิกิริยารีดักชั่น	M <sup>n+</sup> + ne	$\rightarrow$	Μ	(สมการที่ 4.1)
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น	Μ	$\rightarrow$	M <sup>n+</sup> + ne	(สมการที่ 4.2)

ตารางที่ 4. 2 ปฏิกิริยารีดักชั่นและค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของโลหะนิกเกิลและทังสเตน[10]

ปฏิกิริยา	ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน (โวลต์)
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0
Ni <sup>2+</sup> + 2e <sup>−</sup> → Ni	-0.257
$WO_4^{2-} + 4H_2O + 6e^- \rightarrow W + 8OH^-$	-1.074

เมื่อพิจารณาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของขั้วไฟฟ้าสำหรับวัสดุ นิกเกิล และทังสเตน จากตาราง ที่ 4.2 พบว่ามีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่ -0.257 โวลต์ และ -1.074 โวลต์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานดังกล่าว พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของทังสเตนมีค่าเป็นน้อย กว่าค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของนิกเกิล ทำให้นิกเกิลจึงเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นได้ดีกว่า อีกทั้งการที่ ทังสเตนมีค่าศักย์ไฟฟ้าน้อยกว่าทำให้เมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะมีความรุนแรงกว่า ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ Amnuaysak Chianpairot [10] รวมถึง Narasak Sanwang [3] ดังนั้นการเพิ่ม ความหนาแน่นกระแส reverse pulse จึงส่งผลทำให้ชั้นเคลือบที่ได้มีปริมาณทังสเตนลดลง โดย ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแส reverse pulse และปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบดัง แสดงในภาพที่ 4.3



## ภาพที่ 4. 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส reverse pulse และปริมาณทั้งสเตนในชั้น เคลือบของวัสดุผสมนิกเกิลทั้งสเตนผลึกนาโน

#### 4.2.2 ขนาดเกรน XRD

การเติมธาตุผสม เพื่อทำให้โลหะบริสุทธิ์กลายเป็นโลหะผสม สามารถที่จะช่วยทำให้ขนาด เกรนที่ได้มีขนาดเล็กลงได้ โดยในวัสดุนิกเกิลที่มีทังสเตนเป็นธาตุผสม อ้างอิงจากงานวิจัยของ Amnuaysak Chianpairot [10] รวมถึง Christopher A. Schuh[12] ที่พบว่าปริมาณของธาตุ ทังสเตนที่เพิ่มสูงขึ้นในชั้นเคลือบวัสดุโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน ทำให้โครงสร้างที่ได้ของชั้นเคลือบมี ขนาดเกรนที่ลดลง เนื่องจาก อะตอมของธาตุทังสเตนจะเกิดการแยกตัวไปอยู่ที่บริเวณขอบเกรน (grain segregation) [31] และกลไกการแยกตัวที่ขอบเกรนดังกล่าวทำให้การมีธาตุทังสเตนมากในชั้น เคลือบจะส่งผลทำให้โครงสร้างที่ได้มีขนาดเกรนที่เล็กในระดับนาโนเมตร ผลจากการเติมธาตุทังสเตน จะทำให้เกิดพลังงานอิสระจากการแยกตัวที่ขอบเกรน และส่งผลทำให้พลังงานรวมของระบบลด น้อยลง ดังสมการที่ 4.3

$$\gamma = \gamma_0 - \Gamma (G_{seg} + RT lnX)$$
 (สมการที่ 4.3)

 $\gamma$  คือ พลังงานขอบเกรน

 $\gamma_{\scriptscriptstyle 0}$  *คือ* ค่าของพลังงานขอบเกรนของวัสดุที่บริสุทธิ์

G<sub>seg</sub> คือ พลังงานของการแยกตัวของธาตุผสม

Г คือ ค่าจำเพาะของปริมาณธาตุผสมที่มากเกินความสามารถในการละลาย

R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส

T คือ อุณหภูมิ

์จุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University



ภาพที่ 4. 4 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทั้งสเตน ขึ้นงาน A, B, C และ D

และจากผลการทดลองของ X-ray diffraction จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานชั้น เคลือบนิกเกิลทังสเตนที่มีปริมาณทังสเตนที่สูงขึ้นจะทำให้ความสูงของพีคหลักลดต่ำลง ซึ่งจากความ สูงของพีคดังกล่าวสามารถที่จะนำไปใช้หาขนาดของผลึกแบบสัมพัทธ์ได้ โดยใช้โปรแกรม JADE ซึ่ง ผลการทดลองของขนาดผลึกสัมพัทธ์ได้แสดงในตารางที่ 4.1 และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการ ทดลองของส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบจากเทคนิค EDS จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณธาตุทังสเตนในชั้นเคลือบและขนาดเกรนดังนี้ คือ การที่ชั้นเคลือบ นิกเกิลทังเสตนมีปริมาณธาตุทังสเตนในชั้นเคลือบมากขึ้นจะส่งผลทำให้มีขนาดเกรนที่เล็กลง อีกทั้งพีค X-ray diffraction ที่ได้ยังมีลักษณะที่เอนเอียงมาทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้น ของธาตุทังสเตน แสดงถึงการมีธาตุทังสเตนเข้าไปแทรกอยู่ในระนาบผลึกทำให้โครงสร้างเกิดการ ขยายขนาด เนื่องจากขนาดอะตอมของธาตุทังสเตนมีขนาดใหญ่กว่าขนาดอะตอมของนิกเกิล

## 4.2.3 โครงสร้างจุลภาคของพื้นผิวชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบนิกเกิลทั้งสเตน ในชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีปริมาณธาตุทั้งสเตนแตกต่างกัน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเพิ่มปริมาณธาตุ ทั้งสเตนที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด(SEM) เพื่อหา โครงสร้างจุลภาคของบริเวณพื้นผิวชั้นเคลือบ โดยในภาพที่ 4.5 แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของชั้น เคลือบนิกเกิลทั้งสเตนที่ได้จากการใช้เทคนิค SEM



ภาพที่ 4. 5 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคพื้นผิวของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตนผลึกนาโน ก) ชิ้นงาน A ข) ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างที่ได้ในภาพที่ 4.5 จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของเกรน ที่ เรียกว่าโนดูล โดยพบว่าชิ้นงาน A ที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำกว่าในชั้นเคลือบจะส่งผลทำให้โครงสร้าง จุลภาคที่ได้มีลักษณะของโนดูลที่หยาบกว่า ชิ้นงาน B, C และ D ที่มีปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบสูง กว่า ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการแยกตัวที่ขอบเกรนของธาตุทั้งสเตน และผลการทดลอง ขนาดผลึกสัมพัทธ์ดังตารางที่ 4.1

#### 4.2.4 ค่าความแข็งผิว

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวัดค่าความแข็งผิวของชิ้นงานโดยใช้เทคนิค ไมโครวิกเกอร์ (Microvicker hardness) รุ่น Mitutoyo hardness testing machine ใช้น้ำหนักกด 50 g และทำ การกด 12 ครั้งเพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความแข็งผิว ได้ผลการ ทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.3

ชื่อชิ้นงาน	ค่าความแข็งผิวเฉลี่ย(GPa)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
A (Ni-6.3W)	3.48	0.40
B (Ni-8.7W)	5.08	0.33
C (Ni-13.8W)	6.77	0.15
D (Ni-29.4W)	7.10	0.51

ตารางที่ 4. 3 ผลการทดลองความแข็งผิวของชั้นเคลือบนิกเกิลทั้งสเตนประเภทชั้นเคลือบเดี่ยว

จากผลการทดลองค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบที่มีปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบที่แตกต่าง กันพบว่า การที่ชั้นเคลือบมีปริมาณธาตุทั้งสเตนมากขึ้นจะส่งผลทำให้ชั้นเคลือบมีค่าความแข็งผิวเพิ่ม สูงขึ้น เนื่องจากการมีธาตุผสมในชั้นเคลือบจะส่งผลทำให้โครงสร้างที่เกิดขึ้นมีขนาดเกรนที่ลดลง ตาม กลไกการแยกตัวตามขอบเกรน (grain segregation) ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.4 และผลจาก การที่วัสดุที่มีขนาดเกรนเล็กกว่าจะมีค่าความแข็งแรงที่มากกว่า ซึ่งอธิบายได้ตามความสัมพันธ์ของ Hall-Petch ที่ว่าความแข็งผิวจะมีค่าแปรผกผันกับขนาดเกรน ดังสมการที่2.4  $H = H_0 + K_H d^{-1/2}$ สอดคล้องกับหลักการของโลหะเกรนละเอียด (grain refinement) ที่เกี่ยวข้องกับกลไกในการเพิ่ม ความแข็งแรงของวัสดุโลหะอันเนื่องมาจากการที่มีขนาดเกรนที่เล็ก

**CHULALONGKORN UNIVERSITY** 

### 4.2.5 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (friction coefficient)

การหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชั้นเคลือบ ได้จากการทดสอบการสึกหรอของชั้น เคลือบโดยวิธี ball-on-disc โดยการใช้โปรแกรม Plint ในการตรวจสอบ ได้ผลการทดลองดังแสดง ในภาพที่ 4.6 และจากผลการทดลองดังภาพที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชั้น เคลือบในตอนเริ่มต้นจะมีค่าน้อยและจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนค่อนข้างคงที่ ดังนั้นเพื่อการนำค่ามาใช้ ในการเปรียบเทียบ ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ย โดยเลือกในช่วง 200-500 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีความเสถียร ได้ผลการคำนวณดังภาพที่ 4.7 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานชั้นเคลือบที่มีปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบที่สูงขึ้น จะ ส่งผลทำให้ชั้นเคลือบมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วย แสดงถึงการที่ชั้นเคลือบมี ปริมาณธาตุทังสเตนสูงและมีขนาดเกรนละเอียดจะทำให้มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่สูงขึ้นด้วย



ภาพที่ 4. 6 กราฟแสดงผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ได้จากการทดสอบการ สึกหรอ ของชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยวนิกเกิลทังสเตน







## 4.2.6 ค่าความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาค่าความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบโดยการทดลอง ด้วยเทคนิค ball-on-disc โดยในการทดสอบจะใช้ลูกบอลที่ทำมาจากวัสดุ ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) ในสภาวะที่ไม่มีสารหล่อลื่น โดยภายหลังการทดสอบการสึกหรอแบบ ball-on-disc จะได้ชิ้นงานที่ มีร่องรอยการสึกหรอลักษณะวงแหวน และนำไปตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบพื้นผิว Profilometer จะสามารถหาได้ถึงลักษณะภาคตัดขวางของร่องการสึกหรอทั้งแบบสามมิติ และ สองมิติ ดังแสดงในภาพที่ 4.8-4.11

> จุฬาลงกรณมหาวทยาลย Chulalongkorn University



ภาพที่ 4. 8 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ A (Ni-6.3W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 9 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ B (Ni-8.7W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ


ภาพที่ 4. 10 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ C (Ni-13.8W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 11 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ D (Ni-29.4W) ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

จากผลการทดลองดังรูปที่ 4.8 – 4.11 สามารถนำรูปแบบของพื้นที่ภาคตัดขวางร่องการสึก หรอแบบ 2 มิติ ที่ได้จากเครื่อง profilometer มาคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตรการสึกหรอ และได้ผล การทดลองปริมาตรการสึกหรอ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

วัสดุ	ปริมาตรการสึกหรอ (x10 <sup>6</sup> µm <sup>3</sup> )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x10 <sup>6</sup> μm <sup>3</sup> )
A	10.02	1.39
В	6.85	1.32
С	4.96	1.48
D	3.38	0.51

ตารางที่ 4. 4 ผลปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน

จากการทดสอบปริมาตรการสึกหรอที่ได้จากเทคนิค ball-on-disc ดังแสดงในตารางที่ 4.4 พบว่า ชิ้นงานที่มีปริมาณธาตุทั้งสเตนสูงจะส่งผลทำให้ปริมาตรการสึกหรอลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ ความสัมพันธ์ของ Archard ในสมการที่ 2.4 ที่ว่า ความแข็งผิวส่งผลต่อความต้านทานการสึกหรอ แบบขัดสีของวัสดุ จะเห็นได้จากชิ้นงานที่มีขนาดเกรนเล็กและมีค่าความแข็งผิวที่สูงจะมีปริมาตรการ สึกหรอที่ต่ำกว่าชิ้นงานที่มีขนาดเกรนใหญ่และมีค่าความแข็งผิวต่ำ

นอกจากนี้ยังได้มีการเปรียบเทียบกับผลการทดลองของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ที่กล่าว มาแล้วในหัวข้อที่ 4.2.5 พบความสัมพันธ์ดังนี้คือ การที่ชิ้นงานมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่สูงจะ ทำให้ชิ้นงานมีการสึกหรอที่มากกว่า ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองเพื่อหาโครงสร้างจุลภาคภายใน ร่องการสึกหรอโดยใช้เทคนิค SEM ที่จะแสดงหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกลไกในการเกิดการสึกหรอจาก เทคนิค ball on disc โดยจากผลการทดลองของโครงสร้างจุลภาคที่ได้จากพื้นผิวร่องการสึกหรอ ของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย 500 เท่า และกำลังขยาย 3000 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 4.12 และ 4.13 ตามลำดับ



ภาพที่ 4. 12 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย 500 เท่า ก) ชิ้นงาน A ข) ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D



ภาพที่ 4. 13 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย 3000 เท่า ก) ชิ้นงาน A ข) ชิ้นงาน B ค) ชิ้นงาน C ง) ชิ้นงาน D

จากผลการทดลองโครงสร้างจุลภาคของร่องการสึกหรอที่เกิดขึ้น ในภาพที่ 4.12 และ 4.13 สามารถที่จะสังเกตได้ถึงทิศทางของการขัดสีในทุกชิ้นงานคือ A, B, C, และ D ที่เป็นหลักฐานแสดง ถึงกลไกของการสึกหรอแบบขัดสี (abrasive wear) อีกทั้งยังสามารถสังเกตถึงทรานสเฟอร์ฟิล์ม (transfer film) ที่มีลักษณะเป็นริ้วที่เกิดจากการที่เนื้อวัสดุหลุดออกและถูกบดขยี้และเกาะติด ตาม ลักษณะของกลไกการสึกหรอแบบเกาะติด (adhesive wear) โดยทรานสเฟอร์ฟิล์มจะมี ้ส่วนประกอบทางเคมีคือ นิกเกิลออกไซด์ และนิกเกิลทั้งสเตน[3] ทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า การทดสอบการสึกหรอแบบ ball-on-disc ซึ่งเป็นการสึกหรอแบบไถล กับวัสดุชั้นเคลือบนิกเกิล ทั้งสเตน จะประกอบไปด้วยกลไกการสึกหรอแบบขัดสีและกลไกการสึกหรอแบบเกาะติด และจาก การพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้างภายในร่องการสึกหรอที่กำลังขยายสูง ดังรูปที่ 4.13 พบว่า เมื่อนำชิ้นงานที่มีปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบแตกต่างกันของวัสดุ A, B, C, และ D มาเปรียบเทียบ ชิ้นงาน A ในรูปที่ 4.13ก จะมีการสึกหรอที่รุนแรงมากที่สุด สังเกตได้จากรอยแตกและความ กัน ้สม่ำเสมอภายในโครงสร้างจุลภาคร่องการสึกหรอ และความรุนแรงของการสึกหรอจะลดน้อยลงเมื่อ มีปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการทดลองของค่าปริมาตรการสึกหรอใน ตารางที่ 4.4

นอกจากนี้เมื่อนำผลของปริมาตรการสึกหรอที่ได้จากเทคนิค ball-on-disc ไปหา ความสัมพันธ์กับผลการทดลองค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน ดังที่กล่าวมาแล้วใน หัวข้อ 4.2.4 ได้ความสัมพันธ์ดังกราฟในภาพที่ 4.14 ดังความสัมพันธ์ของ Archard ในสมการที่ 2.4



ภาพที่ 4. 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนกลับของค่าความแข็งผิวและปริมาตรการ สึกหรอ ของชิ้นงานชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตน

จากกราฟดังภาพที่ 4.14 จะเห็นได้ว่าค่าปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล ทังสเตนผลึกนาโน ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อชั้นเคลือบมีความแข็งผิวที่ลดลง สอดคล้องกับ ความสัมพันธ์ของ Archard ผ่านกลไกการสึกหรอแบบเกาะติดและแบบขัดสี

#### 4.3 การชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

- การชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีจำนวนชั้นเคลือบที่แตกต่างกัน โดยมีการควบคุมความหนา โดยรวมให้เท่ากัน
- การชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน โดยมีการควบคุมให้มี จำนวนชั้นเคลือบ ความหนาของแต่ละชั้นเคลือบ และความหนาโดยรวมให้เท่ากัน

เพื่อป้องกันการสับสนในการเรียกชื่อชิ้นงาน ในงานวิจัยนี้ได้ทำการตั้งชื่อชิ้นงาน การชุบแบบ หลายชั้นใน 3 ระบบ โดยในแต่ละระบบนั้นจะทำการชุบชิ้นงานที่ระยะเวลารวมเท่ากัน เพื่อให้ได้ ความหนารวมเท่ากัน ดังนี้คือ ชิ้นงานในกลุ่ม AB-xx เป็นการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุ A สลับ B ,AC-xx เป็นการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุ A สลับ C และ AD-xx เป็นการชุบเคลือบ แบบหลายชั้นของวัสดุ A สลับ D โดยที่ xx ที่กำกับท้ายชื่อแสดงถึงตัวเลขของค่าความหนาของชั้น เคลือบย่อย (individual layer thickness) ในหน่วยของนาโนเมตร



ชื่อชิ้นงาน	ความหนาชั้น เคลือบย่อย (นาโนเมตร)	การสลับ สัญญาณ	ระยะเวลาของแต่ละชั้น (นาที)	จำนวนขั้นเคลือบย่อย
AB-5000	5000		10	6
AB-2500	2500	3111/2	5	12
AB-500	500	1 4 5 U D	1	60
AB-250	250	А МИЦ В	0.5	120
AB-50	50	///	0.1	600
AB-25	25	163	0.05	1200
AC-5000	5000	KR	10	6
AC-2500	2500		5	12
AC-500	500	A @ @ 1 C	4	60
AC-250	250		0.5	120
AC-50	50	C. S. S. S.	0.1	600
AC-25	25		0.05	1200
AD-5000	5000		10	6
AD-2500	2500		5	12
AD-500	500	A @ @ 1 D	เวทย <sub>า</sub> เลย	60
AD-250	250		0.5	120
AD-50	50		0.1	600
AD-25	25		0.05	1200

ตารางที่ 4. 5 ชิ้นงานการชุบเคลือบนิกเกิลทั้งสเตนแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทาง เคมี และตัวแปรต่าง ๆ

#### 4.3.1 โครงสร้างที่ได้จากการชุบเคลือบแบบหลายชั้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการหาโครงสร้างตัดขวางของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ได้จากการชุบโดย วิธีการชุบไฟฟ้าที่มีการใช้กระแส reverse pulse โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าการปรับค่ากระแสไฟฟ้าจากการชุบเคลือบโดยการชุบไฟฟ้าสามารถที่ จะได้โครงสร้างของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น โดยจะนำชิ้นงาน AC-5000, AC-500 และ AC-50 เป็น ตัวแทนของชิ้นงานทั้งหมดในการพิสูจน์หาโครงสร้างภาคตัดขวางของชิ้นงาน ได้ผลการทดลองดัง ปรากฏในภาพที่ 4.15 เมื่อพิจารณาภาพ 4.15ก จากภาพ จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะสังเกตความเป็น ชั้นของโครงสร้างได้อย่างชัดเจน และปรากฏเป็นจำนวน 6 ชั้น สอดคล้องกับการทดลองที่ได้ออกแบบ การทดลองไว้ และโครงสร้างของชิ้นงาน AC-60 ที่มีจำนวนชั้นเคลือบ 60 ชั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.15ข จะปรากฏลักษณะของริ้วแนวขวางของชั้นเคลือบที่แสดงว่าโครงสร้างที่ได้มีหลายชั้นซ้อนทับ กันไปมาในแนวขวางสอดคล้องกับการออกแบบการทดลอง และในชิ้นงาน AC-600 ที่มีจำนวนชั้น เคลือบ 600 ชั้น จากผลการทดลองภาพที่ 4.15ค จะเห็นได้ว่าไม่สามารถที่จะสังเกตริ้ว ๆ ที่แสดงถึง รอยต่อของแต่ละชั้นเคลือบย่อยได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกวาด มีความละเอียดไม่เพียงพอในการตรวจสอบ





ภาพที่ 4. 15 โครงสร้างจุลภาคของภาคตัดขวางที่ได้จากการชุบขึ้นงานแบบหลายชั้น ก) ชิ้นงาน AC-5000, ข) ชิ้นงาน AC-500, ค) ชิ้นงาน AC-50

และนอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังได้มีการใช้เทคนิค EPMA (electron probe micro analyzer) เพื่อช่วยในการพิสูจน์โครงสร้างแบบหลายชั้นที่ผ่านชุบเคลือบนิกเกิลทังสเตนแบบหลาย ชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมี โดยจากเทคนิคดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงการกระจายตัวของ ธาตุต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง แสดงออกมาในรูปแบบของความหนาแน่นของเม็ดสี ดังแสดงในภาพที่ 4.16 – 4.20







ภาพที่ 4. 17 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแต่ละชนิดที่ได้จากเทคนิค EPMA แบบรวม ของชิ้นงาน AC-5000







ภาพที่ 4. 19 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุทั้งสเตน ที่ได้จากเทคนิค EPMA ของ ชิ้นงาน AC-5000



ภาพที่ 4. 20 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุนิกเกิล ทั้งสเตน และนิกเกิลทั้งสเตน ที่ได้ จากเทคนิค EPMA ของชิ้นงาน AC-5000

จากผลการทดลองที่ได้จากเทคนิค EPMA ทำให้สามารถยืนยันให้ทราบได้ว่าชิ้นงานการชุบ เคลือบแบบหลายชั้น AC-5000 ที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยประมาณ 5 ไมครอน สามารถที่จะมี โครงสร้างแบบสลับชั้นของวัสดุ A และวัสดุ C ซึ่งมีปริมาณและการการกระจายตัวของธาตุทังสเตนที่ ต่างกัน โดยจะเห็นได้ชัดเจน ดังภาพที่ 4.19 อีกทั้งยังสามารถที่จะระบุว่าบริเวณใดของชั้นเคลือบที่ จะประกอบไปด้วยธาตุนิกเกิล และวัสดุพื้นที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก

## 4.3.2 ส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของส่วนประกอบทางเคมีของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลาย ชั้น โดยจะทำการวิเคราะห์โครงสร้างภาคตัดขวางของชิ้นงาน AC-5000 เพื่อเป็นตัวแทนในการหา ส่วนประกอบทางเคมี เนื่องจากสามารถสังเกตและแยกชั้นเคลือบย่อยได้ง่าย โดยใช้เทคนิค EDS วิเคราะห์ที่โครงสร้างภาคตัดขวางของชั้นเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 4.21 ได้ผลการทดลองดังนี้ คือ ชั้นเคลือบย่อยสีเข้มดังแสดงโดยเครื่องหมายบวกในภาพที่ 4.21 มีส่วนประกอบทางเคมีคือ Ni-7.0W และชั้นเคลือบย่อยที่มีสีอ่อนดังแสดงโดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในภาพที่ 4.21 มีส่วนประกอบทางเคมีคือ Ni-7.0W และชั้นเคลือบย่อยที่มีสีอ่อนดังแสดงโดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในภาพที่ 4.21 มีส่วนประกอบทางเคมี คือ Ni-11.3W ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการออกแบบการชุบเคลือบที่กำหนดไว้โดยใช้วัสดุ A และ C ที่มีส่วนประกอบทางเคมีคือ Ni-6.3W และ Ni-13.8W ตามลำดับ พบว่ามีความแตกต่างกับที่ ได้ออกแบบไว้ 20-22% ทั้งนี้จึงสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ได้จาก งานวิจัยนี้มีการสลับของส่วนประกอบทางเคมีตามที่ได้มีการออกแบบไว้



ภาพที่ 4. 21 ภาพลักษณะการหาส่วนประกอบทางเคมีในโครงสร้างจุลภาคของภาคตัดขวาง ชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้น AC-5000 โดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสดงตำแหน่งชั้นเคลือบย่อย C และเครื่องหมายบวกแสดงตำแหน่งชั้นเคลือบย่อย A

## 4.4 ความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น โดยได้ทำการเลือก วัสดุที่จะนำมาชุบเคลือบทั้งหมด 3 ระบบคือ AB-xx เป็นการชุบเคลือบวัสดุ A สลับวัสดุ B ที่ความ หนาชั้นเคลือบย่อยต่าง ๆ , AC-xx เป็นการชุบเคลือบวัสดุ A สลับวัสดุ C ที่ความหนาชั้นเคลือบย่อย ต่าง ๆ และ AD-xx เป็นการชุบเคลือบวัสดุ A สลับวัสดุ D ที่ความหนาชั้นเคลือบย่อยต่าง ๆ (ตัวเลข xx แสดงถึงความหนาของชั้นเคลือบย่อย) ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นงานทั้งหมดดังตารางที่ 4.6 โดยควบคุมระยะเวลาในการชุบเคลือบที่ 60 นาที โดยจากระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ได้ชั้นเคลือบที่มี ความหนาทั้งหมดประมาณ 30 ไมครอน โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการวัดค่าความแข็งผิวของชิ้นงาน โดยใช้เครื่อง Microvicker hardness รุ่น Mitutoyo hardness testing machine ใช้น้ำหนักกด 50 g และทำการกด 12 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความแข็งผิว สภาวะเดียวกับการทดสอบความแข็งผิวในระบบชั้นเคลือบเดี่ยว ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.6 และได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิวและความหนาชั้นเคลือบย่อยดังภาพที่ 4.22



ภาพที่ 4. 22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบย่อย และค่าความแข็งผิว ของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น

จากผลการทดลองดังตารางที่ 4.6 พบว่าเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของค่าความแข็งผิวและ ความหนาของชั้นเคลือบย่อย พบว่า เมื่อชั้นเคลือบย่อยมีความหนาลดลง จะส่งผลทำให้ค่าความแข็ง ผิวของชั้นเคลือบเพิ่มสูงขึ้น[33] โดยจะเกิดทั้งในระบบ AB-xx, AC-xx และ AD-xx ทั้งนี้สามารถ อธิบายได้โดย การที่ชั้นเคลือบย่อยมีความหนาในระดับนาโนเมตร โครงสร้างแบบสลับชั้นที่ภายในจะ ประกอบไปด้วยรอยต่อของแต่ละชั้นเคลือบมากมาย รอยต่อเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการต้านทานการ เคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่นในการเคลื่อนที่ข้ามชั้นเคลือบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุชั้น เคลือบ โดยอ้างอิงจากหลักการของการชุบเคลือบแบบหลายชั้น [29, 30, 33, 34] กล่าวคือ ความ แข็งแรงที่เพิ่มสูงขั้น เกี่ยวข้องกับ ความไม่เข้ากันของค่ามอดูลัส และความไม่เข้ากันของค่าตัวแปร ผลึก ระหว่างชั้นเคลือบย่อยที่อยู่ติดกัน โดยที่ความไม่เข้ากันของค่ามอดูลัสจะทำให้เกิดรอยต่อของ ชั้นเคลือบ อีกทั้งความไม่เข้ากันของตัวแปรผลึกจะทำให้เกิดความเค้นที่จะช่วยขัดขวางการเคลื่อนที่ ของดิสโลเคชั่น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการสลับส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ส่งผลต่อค่า ความแข็งผิว พบว่า ที่ความหนาชั้นเคลือบย่อยเท่ากันที่ ความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นใน ระบบ AD จะมีค่าสูงกว่าระบบ AC และ AB ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุ D เป็นวัสดุที่มีเกรนขนาด เล็กและมีค่าความแข็งผิวที่สูง เมื่อนำมาใช้ในการสลับให้เป็นโครงสร้างแบบหลายชั้นจึงทำให้ได้ความ แข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่สูง ในทางตรงกันข้ามกับในระบบ AB ซึ่งประกอบไปด้วยเกรน ขนาดใหญ่นำมาสลับกัน จึงทำให้ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นในระบบ AB มีค่าน้อย

นอกจากนี้จากการที่ในระบบ AD ยังมีปริมาณทั้งสเตนเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ AC และ AB จึงทำให้ชิ้นงานในระบบ AD มีค่าความแข็งผิวที่สูง ผ่านกลไกของสารละลายของแข็งที่เด่นชัด กว่าในระบบที่มีปริมาณของทั้งสเตนเฉลี่ยน้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Timothy J. Rupert และ C.A. Schuh [4] ที่พบว่า ที่ขนาดเกรนเท่ากัน ชิ้นงานที่มีปริมาณทั้งสเตนสูงจะมีค่าความแข็งผิว ที่ดีกว่าชิ้นงานที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี พบว่าความแข็งผิวของชิ้นงานที่ทำการชุบเคลือบแบบหลายชั้นมีค่าความแข็งผิวที่ มากกว่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบวัสดุทังสเตนต่ำที่เลือกนำมาสลับชุบเคลือบ แต่ยังคงมีค่าต่ำกว่า ความแข็งผิวของชั้นเคลือบวัสดุทังสเตนสูงที่เลือกนำมาสลับชุบเคลือบ เมื่อพิจารณาหลักการของวัสดุ คอมโพสิทที่ประกอบไปด้วยวัสดุสองชนิดผสมกัน มีหลักการของกฎการผสม ในงานวิจัยนี้จึงได้มีการ หาค่าความแข็งผิวโดยใช้กฎการผสม เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลของค่าความแข็งผิวในชั้นเคลือบที่มี โครงสร้างแบบหลายชั้น โดยผลการคำนวณค่าความแข็งผิวตามกฎการผสมดังแสดงในตารางที่ 4.7

กลุ่มชิ้นงาน	ชื่อชิ้นงาน	ค่าความแข็งผิว (GPa)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	AB-5000	3.74	0.12
	AB-2500	3.76	0.25
AR NO	AB-500	4.38	0.43
AD-XX	AB-250	4.56	0.33
	AB-50	4.94	0.27
	AB-25	5.13	0.33
	AC-5000	3.74	0.19
	AC-2500	4.00	0.53
	AC-500	4.50	0.49
AC-XX	AC-250	4.94	0.61
	AC-50	6.71	0.68
	AC-25	6.69	0.55
Сн CHI AD-xx	AD-5000	4.50	<b>AB</b> 0.33
	AD-2500	5.59	STY 0.56
	AD-500	5.76	0.39
	AD-250	6.44	0.30
	AD-50	7.00	0.11
	AD-25	6.98	0.45

ตารางที่ 4. 6 ผลการทดลองค่าความแข็งผิวของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของนิกเกิล ทังสเตน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความแข็งผิว

รายการวัสดุ	ค่าความแข็งผิว จากกฎการผสม (GPa)	ค่าความแข็งผิว จากการชุบเคลือบโครงสร้างแบบหลายชั้น (GPa)
A และ B	4.28	4.94
A และ C	5.12	6.71
A และ D	5.29	7.00

ตารางที่ 4. 7 ค่าความแข็งผิวที่ได้จากกฎการผสม เปรียบเทียบกับค่าความแข็งผิวของโครงสร้าง แบบหลายชั้นที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อย 50 นาโนเมตร

จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาผลของค่าความแข็งผิวที่ได้จากการคำนวณตามกฎการผสม ของวัสดุ 2 ชนิด เปรียบเทียบกับค่าความแข็งผิวที่ได้จากโครงสร้างแบบหลายชั้นที่มีความหนาชั้น เคลือบย่อย 50 นาโนเมตร พบว่าความแข็งผิวที่ได้จากโครงสร้างแบบหลายชั้นมีค่าความแข็งผิวที่ มากกว่าค่าความแข็งผิวตามกฎการผสม โดยคิดเป็น 15, 31 และ 32 เปอร์เซ็นต์ ในระบบของ AB, AC, และ AD ตามลำดับ แสดงถึงผลของการที่ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นทำให้ค่าความแข็งผิวเพิ่ม สูงขึ้นจากการที่รอยต่อระหว่างชั้นเคลือบย่อยทำหน้าที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น ดังที่กล่าว มาก่อนหน้านี้

## 4.5 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น เพื่อศึกษาผลของระบบส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้ในการชุบเคลือบที่แตกต่างกัน คือ AB-50, AC-50 และ AD-50 รวมถึงศึกษาผลของค่าความหนาของชั้นเคลือบย่อยในระบบชิ้นงาน AC-xx ที่ความหนาชั้นเคลือบย่อยต่าง ๆ โดยผลการทดลองได้จากในระหว่างการทดสอบการสึกหรอด้วย เทคนิค ball on disc ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.5 โดยผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียด ทาน ของชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50 ที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้ในการชุบเคลือบที่ แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.23 และ 4.24



ภาพที่ 4. 23 ผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ได้จากระหว่างการทดสอบการสึกหรอ ของชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นในระบบการชุบเคลือบแบบสลับต่าง ๆ



ภาพที่ 4. 24 กราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ย ของชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลาย ชั้นในระบบการชุบเคลือบแบบสลับต่าง ๆ

จากผลของส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้ในการชุบเคลือบที่แตกต่างกัน คือ AB-50, AC-50 และ AD-50 และค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ย พบว่า ชิ้นงาน AD-50 จะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด ทานเฉลี่ย มากที่สุด ตามมาด้วยชิ้นงาน AC-50 และชิ้นงาน AB-50 จะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เฉลี่ยต่ำที่สุด และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยในชั้นเคลือบเดี่ยว ของวัสดุ A, B, C และ D พบว่า ปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เฉลี่ย ทำให้ชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ประกอบไปด้วยวัสดุที่มีปริมาณทั้งสเตนสูงจะทำให้ ชิ้นงานดังกล่าวมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยที่สูงตามไปด้วย

และผลของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ย ที่ได้จากขึ้นงานโครงสร้างแบบหลายชั้นของ วัสดุ A และ C ในกลุ่มชิ้นงาน AC-xx มีความสัมพันธ์กับค่าความหนาของชั้นเคลือบย่อย ดังแสดงใน ภาพที่ 4.25 จากผลการทดลองในภาพที่ 4.26 พบว่าชิ้นงานที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยน้อย มี แนวโน้มทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น



ภาพที่ 4. 25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเฉลี่ยและค่าความ หนาของชั้นเคลือบย่อย ในชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นระบบ AC-xx

## 4.6 ความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น

#### 4.6.1 ผลของความหนาชั้นเคลือบย่อย

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบของความหนาชั้นเคลือบย่อยที่มีต่อความต้านทาน การสึกหรอของชั้นเคลือบ โดยทำการหาปริมาตรการสึกหรอที่ได้จากเทคนิค ball-on-disc เช่นเดียวกับชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยว ดังรายละเอียดในที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.1 และมีผลการ ทดลองของลักษณะร่องการสึกหรอที่ได้จากเครื่อง profilometer ดังแสดงในภาพที่ 4.26-4.29



ภาพที่ 4. 26 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-5000 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

Chulalongkorn University



ภาพที่ 4. 27 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-500 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 28 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 29 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-25 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

จากผลการทดลองที่ดังรูปที่ 4.26 – 4.29 สามารถนำรูปแบบของพื้นที่ภาคตัดขวางร่องการ สึกหรอแบบ 2มิติ ที่ได้จากเครื่อง profilometer มาคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตรการสึกหรอ และได้ผล การทดลองปริมาตรการสึกหรอ ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4. 8 ผลของปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้น AC-xx	ที่ความหนา
ชั้นเคลือบย่อยต่าง ๆ	

2	ปริมาตรการสึกหรอ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
<ol> <li></li></ol>	(x10 <sup>6</sup> µm <sup>3</sup> )	ปริมาตรการสึกหรอ
5000	13.0	1.05
500	6.6	1.16
50	6.2	0.48
25	5.0	1.40

จากผลการทดลองดังตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าความหนาของชั้นเคลือบย่อยที่ลดลงทำให้ ชิ้นงานมีปริมาตรการสึกหรอที่ลดลง โดยสามารถอธิบายได้โดย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าความ แข็งผิวของชั้นเคลือบในชิ้นงานเดียวกัน พบว่าค่าปริมาณการสึกหรอมีแนวโน้มลดลงเมื่อชั้นเคลือบมี ค่าความแข็งผิวเพิ่มสูงขึ้น โดยผลมาจากการที่รอยต่อของชั้นเคลือบย่อยทำหน้าที่ต้านทานการ เคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่นจึงทำให้ค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับใน ชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยวดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.6

และนอกจากนี้ ผลการทดลองยังสอดคล้องโครงสร้างแบบหลายชั้นที่มีความหนาของชั้น เคลือบย่อยในระดับนาโน จากงานวิจัยของ V.D. Papachristos [18] กล่าวคือ ในโครงสร้างชั้น เคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุที่มีมอดูลัสที่แตกต่างกัน จากการสลับส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่าง กัน ความไม่เข้ากันของมอดูลัสจะทำให้รอยแตกที่จะโตผ่านชั้นเคลือบย่อยเกิดการเบี่ยงเบนทิศทาง การที่ชั้นเคลือบย่อยมีความหนาลดลงจะทำให้ปริมาตรการสึกหรอลดลง เนื่องจากโครงสร้างแบบ หลายชั้นจะทำให้รอยแตกที่ขยายตัวเกิดการเบี่ยงเบนไปในทิศทางขนานกับชั้นเคลือบ จึงลดโอกาสที่ รอยแตกที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายกับวัสดุ ทำให้วัสดุมีความต้านทานการสึกหรอเพิ่มมาก ขึ้น

## 4.6.2 ผลของส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบย่อย

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบของส่วนประกอบทางเคมีของระบบชั้นเคลือบที่ แตกต่อกันของชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50 ที่มีต่อความต้านทานการสึกหรอของชั้น เคลือบ โดยทำการหาปริมาตรการสึกหรอที่ได้จากเทคนิค ball on disc ดังรายละเอียดในที่ได้ กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.1 และมีผลการทดลองของลักษณะร่องการสึกหรอที่ได้จากเครื่อง profilometer ดังแสดงในภาพที่ 4.30-4.32



ภาพที่ 4. 30 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AB-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 31 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 32 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AD-50 ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

จากผลการทดลองที่ดังรูปที่ 4.32 – 4.34 สามารถนำรูปแบบของพื้นที่ภาคตัดขวางร่องการ สึกหรอแบบ 2มิติ ที่ได้จากเครื่อง profilometer มาคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตรการสึกหรอ และได้ผล การทดลองปริมาตรการสึกหรอ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และจากร่องการสึกหรอที่เกิดขึ้นได้มีการ หาค่าลักษณะของภาคตัดขวางร่องการสึกหรอดังแสดงในภาพที่ 4.35

9 2	ปริมาตรการสึกหรอ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ชนงาน	(x10 <sup>6</sup> µm <sup>3</sup> )	(x10 <sup>6</sup> µm <sup>3</sup> )	
AB-50	9.57	1.64	
AC-50	6.25	0.48	
AD-50	3.94	0.67	

ตารางที่ 4. 9 ผลของปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50

จากผลการทดลองดังตาราง 4.9 ชิ้นงาน AD-50 มีปริมาตรการสึกหรอน้อยที่สุด ตามมาด้วย ชิ้นงาน AC-50 และชิ้นงาน AB-50 มีปริมาตรการสึกหรอมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลของลักษณะ และขนาดของร่องการสึกหรอดังรูปที่ 4.33 และจากการพิจารณาเปรียบเทียบกับผลของ ค่าปริมาตรการสึกหรอในวัสดุ A, B, C และ D ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่เลือก นำมาชุบเคลือบส่งผลต่อปริมาตรการสึกหรอ โดยปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบส่งผลต่อ ค่าปริมาตรการสึกหรอ ทำให้ชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ประกอบไปด้วยวัสดุที่มีปริมาณ ทั้งสเตนสูงจะทำให้ชิ้นงานดังกล่าวมีปริมาตรการสึกหรอที่สูงตามไปด้วย



ภาพที่ 4. 33 ลักษณะภาคตัดขวางของร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นในชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50

และในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองเพื่อหาโครงสร้างจุลภาคภายในร่องการสึกหรอโดยใช้ เทคนิค SEM ที่จะแสดงหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกลไกในการเกิดการสึกหรอจากเทคนิค ball-on-disc โดยจากผลการทดลองของโครงสร้างจุลภาคที่ได้จากพื้นผิวร่องการสึกหรอของ ดังแสดงในภาพที่ 4.34



ภาพที่ 4. 34 พื้นผิวร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบที่กำลังขยาย ก) และ ข) ชิ้นงาน AB-50, ค) และ ง) ชิ้นงาน AC-50, จ) และ ฉ) ชิ้นงาน AD-50 ที่กำลังขยาย 500 และ 3000 เท่า ตามลำดับ

จากผลการทดลองการหาโครงสร้างจุลภาคภายในร่องการสึกหรอของชั้นเคลือบของชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50 พบว่าเมื่อพิจารณาที่กำลังขยายเดียวกันคือ 3000 เท่า ในชั้นเคลือบ ของชิ้นงาน AB-50 พบรอยแตกที่แสดงถึงเกิดการสึกหรอที่รุนแรง สอดคล้องกับผลการทดลองของค่า ปริมาตรการสึกหรอที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ และเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าลักษณะของโครงสร้าง จุลภาคภายในร่องการสึกหรอจะสามารถสังเกตได้ถึงรอยของทิศทางการไถลที่แสดงถึงเกิดกลไกการ สึกหรอแบบขัดสี อีกทั้งยังสามารถสังเกตเห็นถึงทรานสเฟอร์ฟิล์ม ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงกลไก การสึกหรอแบบเกาะติด

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลค่าของปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50 กับชิ้นงาน A, B, C และ D กล่าวคือ ค่าปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงานโครงสร้างชั้นเคลือบ แบบหลายชั้นเปรียบเทียบกับปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยวของวัสดุที่มีทั้งสเตนสูง ที่เลือกใช้ในการนำมาสลับ พบว่า ชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้นมีค่าปริมาตรการสึกหรอ ที่มากกว่าชิ้นงานชั้นเคลือบเดี่ยวของชั้นเคลือบทั้งสเตนสูง เพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาจากค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาตรการสึกหรอ อาจกล่าวได้ว่าชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น สามารถที่จะมีค่าความต้านทานการสึกหรออยู่ในระดับเดียวกับวัสดุทั้งสเตนสูงที่เลือกนำมาใช้สลับ

# 4.7 ผลของระยะเวลาในการชุบเคลือบและความหนารวมของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น

ในงานวิจัยนี้ยังได้ทำการศึกษาผลของระยะเวลาในการชุบเคลือบรวมทั้งหมดของขิ้นงานการ ชุบเคลือบแบบหลายชั้นระบบ AC-50 ที่มีการควบคุมให้มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยให้อยู่ในระดับ 50 นาโนเมตร ทั้งนี้เพื่อทำการหาถึงผลกระทบของความหนารวมของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีต่อ ค่าความแข็งผิวและค่าปริมาตรการสึกหรอ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาตัวแปรเวลาเพื่อที่จะหาความหนา รวมในการชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่ระยะเวลาแตกต่างกันอีกด้วย โดยจะทำการชุบเคลือบที่ ระยะเวลา 15 นาที, 30 นาที, 60 นาที และ 90 นาที และนำไปวัดความหนารวมของชั้นเคลือบจาก การตรวจโครงสร้างแบบตัดขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แสง ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 4.35

Chulalongkorn University



ภาพที่ 4. 35 ภาพแสดงโครงสร้างของภาคตัดขวางและความหนารวมของขั้นเคลือบแบบหลาย ชั้นในระบบชิ้นงาน AC-xx โดยในการชุบเคลือบรวมที่ระยะเวลา ก) 15 นาที, ข) 30 นาที, ค) 60 นาที และ ง) 90 นาที

และจากผลของค่าความหนารวมของชิ้นงานการชุบเคลือบแบบหลายชั้น ได้ความสัมพันธ์กับ เวลาที่ใช้ในการชุบเคลือบ ดังภาพที่ 4.36 จากความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้เวลาในการชุบเคลือบ เพิ่มขึ้นจะทำให้ได้ความหนารวมของชิ้นงานเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้น

> จุฬาสงกรณมหาวทยาลย Chulalongkorn University



ภาพที่ 4. 36 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการชุบเคลือบ และความหนารวมของชั้นเคลือบ แบบหลายชั้น ในชิ้นงาน AC-50

ในงานวิจัยนี้ได้หาความสัมพันธ์ของค่าความหนารวมที่ส่งผลต่อค่าความแข็งผิวของขั้นเคลือบ แบบหลายชั้นในกลุ่มชิ้นงาน AC-50 ได้ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 4.37 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ชั้นเคลือบในกลุ่มชิ้นงาน AC-50 ที่มีการสลับชั้นเคลือบย่อยด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน อีกทั้งยังมีการ ควบคุมความหนาของแต่ละชั้นเคลือบย่อยให้อยู่ที่ 50 นาโมเมตรเท่ากัน เมื่อนำไปทดสอบค่าความ แข็งผิวแบบไมโครวิกเกอร์ โดยใช้แรงกด 50 กรัม จะทำให้ได้ค่าความแข็งผิวที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ใช้ระยะเวลาในการชุบเคลือบน้อยจะทำให้ได้ความหนาชั้นเคลือบที่บาง จะทำให้ได้ความหนาของชั้นเคลือบไม่เพียงพอต่อการทดสอบคุณสมบัติความแข็งผิวโดย ไมโครวิกเกอร์ กล่าวคือ ความลึกของรอยกดต้องไม่มากกว่า 1 ใน 10 ของความหนารวมของชั้น เคลือบ และจากการคำนวณค่าความลึกเฉลี่ยของรอยกดชิ้นงานจะมีค่าประมาณ 2.8 ไมครอน ทำ ให้ชั้นเคลือบที่มีการชุบเคลือบที่ระยะเวลา 15 นาที และ 30 นาที จะได้รับผลจากวัสดุพื้นเมื่อนำไป ทดสอบหาค่าความแข็งผิว ทำให้ผลของค่าความแข็งผิวลดลง จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่า ความหนาโดยรวมของชั้นเคลือบที่มากโดยปราศจากอิทธิพลของวัสดุพื้น จะไม่ส่งผลต่อค่าความแข็ง ผิวของชั้นเคลือบ



ภาพที่ 4. 37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งผิว และระยะเวลาในการชุบเคลือบ ของชิ้นงาน AC-50

การทดสอบการสึกหรอของชิ้นงานในกลุ่ม AC-50 โดยทดสอบการสึกหรอโดยเทคนิค ball-on-disc จะได้ชิ้นงานที่มีร่องรอยการสึกหรอลักษณะวงแหวน และนำไปตรวจสอบโดยใช้ เครื่องทดสอบพื้นผิว profilometer จะสามารถหาได้ถึงลักษณะภาคตัดขวางของร่องการสึกหรอทั้ง แบบสามมิติ และสองมิติ ดังแสดงในภาพที่ 4.39-4.41และสามารถนำรูปแบบของพื้นที่ภาคตัดขวาง ร่องการสึกหรอแบบ 2 มิติ ที่ได้จากเครื่อง profilometer มาคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตรการสึกหรอ และได้ผลการทดลองปริมาตรการสึกหรอ ดังแสดงในตารางที่ 4.10



ภาพที่ 4. 38 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 15 นาที ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 39 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 30 นาที ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 40 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 60 นาที ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ



ภาพที่ 4. 41 พื้นที่การสึกหรอของชั้นเคลือบ ชิ้นงาน AC-50 ที่ใช้เวลาในการชุบเคลือบ 90 นาที ก) แบบ 2 มิติ และ ข) แบบ 3 มิติ

ซิ้นงาน	ระยะเวลา ในการชุบ เคลือบ	ความหนา รวม (µm)	ความแข็งผิว เฉลี่ย (GPa)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของค่าความแข็ง ผิว	ปริมาตรการสึก หรอเฉลี่ย (10 <sup>-6</sup> um <sup>3</sup> )	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของค่าปริ มาตรการสึก หรอ
	15	12	3.88	0.17	6.29	0.97
AC-50	30	18	6.02	0.57	5.92	0.45
110 50	60	30	6.71	0.68	6.25	0.48
	90	42	6.52	1.09	6.30	0.53

ตารางที่ 4. 10 ผลของการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของชิ้นงาน AC-50 โดยใช้ระยะเวลาต่างกัน

จากผลการทดลองของค่าปริมาตรการสึกหรอดังแสดงในตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาผลของ ปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงาน AC-50 ที่ทำการชุบเคลือบด้วยเวลาต่างกันและมีความหนารวมของ ชิ้นงานที่แตกต่างกัน พบว่ามีค่าอยู่ในระดับเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความหนารวมของชิ้นงาน ไม่ส่งผลต่อปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบ

## 4.8 การเปรียบเทียบปริมาณทั้งสเตนในชั้นเคลือบเฉลี่ยและค่าความแข็งผิว

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบสมบัติด้านความแข็งผิวและปริมาตรการสึกหรอของชั้น เคลือบโลหะผสมนิกเกิลทังสเตน และชั้นเคลือบนิกเกิลทังสเตนแบบหลายชั้นที่มีการสลับ ส่วนประกอบทางเคมี และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณทังสเตนในชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่ประกอบไป ด้วย วัสดุที่มีปริมาณทังสเตนต่างกัน นำมาสลับกันในอัตราส่วนของจำนวนชั้นและความหนาชั้น เคลือบย่อยที่เท่ากัน จึงสามารถหาปริมาณทังสเตนของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นได้จากการหาค่าเฉลี่ย ของวัสดุที่เลือกนำมาสลับ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 โดยการชุบเคลือบแบบหลายชั้นจะเป็นการลด การใช้ปริมาณทังสเตนลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุทังสเตนสูงที่เลือกนำมาสลับ โดยการชุบเคลือบ แบบหลายชั้นสามารถการลดปริมาณการใช้ธาตุทังสเตนลงได้ 16, 37 และ 65 เปอร์เซ็นต์ ในระบบ AB, AC และ AD ตามลำดับ

จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาสมบัติด้านค่าความแข็งผิวของชิ้นงาน AB-50 ที่มีค่า ความแข็งผิว 4.9 GPa เปรียบเทียบกับชิ้นงาน B ที่มีค่าความแข็งผิว 5.1 GPa พบว่าชิ้นงานที่มี ชั้นเคลือบแบบหลายชั้น มีค่าความแข็งผิวที่น้อยกว่าชิ้นงานชั้นเคลือบทังสเตนสูงที่เลือกนำมาสลับ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทำนองเดียวกันกับการเปรียบเทียบชิ้นงาน AC-50 กับชิ้นงาน C และการ เปรียบเทียบชิ้นงาน AD-50 และชิ้นงาน D ที่พบว่าการชุบเคลือบแบบหลายชั้น จะมีค่าความแข็งผิวที่ น้อยกว่าชิ้นงานชั้นเคลือบทังสเตนสูงที่เลือกนำมาสลับเพียงเล็กน้อย จึงสามารถบอกได้ว่า การชุบเคลือบแบบหลายชั้นสามารถคงสมบัติทางด้านความแข็งผิวของชั้นเคลือบไว้ได้เมื่อ เปรียบเทียบกับชิ้นงานชั้นเคลือบทังสเตนสูง

และเมื่อพิจารณาสมบัติทางด้านค่าปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงานชั้นเคลือบแบบหลายชั้น พบว่า ชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อย 50 นาโนเมตร ในชิ้นงาน AB-50, AC-50 และ AD-50 จะมีปริมาตรการสึกหรออยู่ระหว่างค่าปริมาตรการสึกหรอของชั้นเคลือบวัสดุที่เลือก นำมาสลับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าปริมาตรการสึกหรอของชิ้นงาน AC-25 ในตารางที่ 4.8 พบว่าชิ้นงานที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยที่ 25 นาโนเมตร จะมีปริมาตรการสึกหรอที่ใกล้เคียงกับ ชิ้นงานชั้นเคลือบทังสเตนสูง จึงอาจบอกได้ว่าการชุบเคลือบแบบหลายชั้นสามารถที่จะคงคุณสมบัติ ทางด้านความต้านทานการสึกหรอได้ ที่ในชิ้นงานที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อย 25 นาโนเมตร

ชิ้นงาน	ค่าเฉลี่ยปริมาณทังสเตน (at%)	ค่าความแข็งผิว (GPa)	ปริมาตรการสึกหรอ (x10 <sup>6</sup> µm <sup>3</sup> )
A	6.3	3.5	10.02
В	8.7	5.1	6.85
C	13.8	6.8	4.96
D	29.4	7.1	SITY <sup>3.38</sup>
AB-50	7.5	4.9	9.57
AC-50	10.05	6.7	6.25
AD-50	17.85	7.0	3.94

ตารางที่ 4. 11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณทั้งสเตนของชั้นเคลือบและค่าสมบัติกล

# บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงการชุบเคลือบแบบหลายชั้นของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนที่สลับ ส่วนประกอบทางเคมี ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งผิวและความต้านทานการสึกหรอ โดยหาผลกระทบของ ความหนาชั้นเคลือบย่อยและการสลับส่วนประกอบทางเคมี สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

 ในการชุบไฟฟ้าโลหะผสมนิกเกิลทั้งสเตน สามารถที่จะควบคุมปริมาณทั้งสเตนใน ชั้นเคลือบได้ โดยการใช้กระแส reverse pulse ที่สูงขึ้นจะทำให้ชั้นเคลือบมีปริมาณทั้งสเตนลดลง นอกจากนี้ชั้นเคลือบที่มีปริมาณทั้งสเตนสูงจะมีเกรนขนาดเล็กอีกทั้งยังมีค่าความแข็งผิวและความ ต้านทานการสึกหรอที่สูง

 สามารถผลิตโครงสร้างของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของวัสดุนิกเกิลทั้งเสตนที่มีการสลับ ส่วนประกอบทางเคมีจากการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าในอ่างชุบเดี่ยว

3. ผลกระทบของความหนาชั้นเคลือบย่อย

3.1 ค่าความแข็งผิวจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อชิ้นงานมีความหนาชั้นเคลือบย่อยในระดับนาโนเมตร โดยจะมีค่าความแข็งผิวที่มากกว่าค่าจากการคำนวณตามกฎการผสม โดย ชิ้นงาน AD-50 มีค่าความ แข็งผิว 7.0 GPa มีค่าใกล้เคียงและอยู่ในระดับเดียวกับชั้นเคลือบทังสเตนสูง ชิ้นงาน D 7.1 GPa

3.2 ในการทดสอบการสึกหรอแบบ ball on disc จะเกิดการสึกหรอแบบขัดสีและแบบ เกาะติด และการลดลงของความหนาชั้นเคลือบย่อยจะส่งผลทำให้ความต้านทานการสึกหรอมีค่า สูงขึ้น

 ระยะเวลาในการชุบเคลือบที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ชิ้นงานมีความหนารวมเพิ่มขึ้น โดยที่ ความหนารวมของชั้นเคลือบไม่ส่งผลต่อสมบัติทางด้านความแข็งของชั้นเคลือบหากปราศจากผลของ วัสดุพื้น และไม่ส่งผลต่อความต้านทานการสึกหรอของชั้นเคลือบ

5. ผลของการสลับส่วนประกอบทางเคมี โดยชั้นเคลือบที่ประกอบไปด้วยชั้นเคลือบย่อยที่มี ปริมาณทั้งสเตนสูงจะมีค่าความแข็งผิวและความต้านทานการสึกหรอที่สูงกว่าชั้นเคลือบที่ ประกอบด้วยชั้นเคลือบย่อยที่มีปริมาณทั้งสเตนต่ำ โดยชิ้นงาน AD-50 จะมีค่าความต้านทานการ สึกหรอและค่าความแข็งสูงที่สุด

 การชุบเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ 2 ชนิดที่มีปริมาณ ทั้งสเตนต่างกันที่ความหนาชั้นเคลือบย่อย 50 นาโนเมตร จะมีค่าความแข็งผิวที่มากกว่าค่าความแข็ง ผิวที่ได้จากการคำนวณตามกฎการผสม 15, 31 และ 32 เปอร์เซ็นต์ ในระบบ AB, AC และ AD ตามลำดับ

7. จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการชุบเคลือบแบบหลายชั้นโดยให้มีความหนาของชั้นเคลือบ ย่อยที่หนาประมาณ 50 นาโนเมตรจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีค่าความแข็งผิวอยู่ระดับเดียวกับวัสดุ ทังสเตนสูงที่เลือกนำมาสลับ แต่ช่วยลดปริมาณการใช้ธาตุทังสเตนลงได้ 16, 37 และ 65 เปอร์เซ็นต์ ในระบบ AB, AC และ AD ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนในการผลิต เนื่องจากทังสเตนเป็นโลหะที่ มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับนิกเกิล

#### <u>ข้อเสนอแนะ</u>

1.ควรมีการศึกษาการยึดติดของชั้นเคลือบ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการนำวัสดุไป ใช้งาน

2.ควรมีการศึกษาการทดสอบการสึกหรอด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงกลไกการสึกหรอ แบบอื่น ๆ

#### รายการอ้างอิง

- 1. Mellor, B.G., *Surface coatings for protection against wear*. 2006, Cambridge England: Woodhead publishing limited.
- 2. Kung-Hsu Houa, Ming-Chang Jeng, and M.-D. Ger, *A study on the wear resistance characteristics of pulse electroforming Ni–P alloy coatings as plated.* Wear, 2006. **262 (2007)**: p. 833–844.
- Narasak Sunwang, Panyawat Wangyao, and Y. Boonyongmaneerat, *The effects* of heat treatments on hardness and wear resistance in Ni–W alloy coatings. Surface & Coatings Technology 2011. 206 (2011): p. 1096–1101.
- 4. Timothy J. Rupert and C.A. Schuh, *Sliding wear of nanocrystalline Ni–W: Structural evolution and the apparent breakdown of Archard scaling.* Acta Materialia 2010. **58 (2010)**: p. 4137–4148.
- A.S.M.A. Haseeb, U. Albers, and K. Badea, *Friction and wear characteristics of electrodeposited nanocrystalline nickel-tungsten alloy films.* Wear 2007. 264 (2008): p. 106–112.
- A. Grosjeana, et al., *Hardness, friction and wear characteristics of nickel-SiC electroless composite deposits.* Surface and Coatings Technology . , 2000.
   137 (2001): p. 92-96.
- 7. Wood, R.J.K., *Tribology of thermal sprayed WC–Co coatings.* Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 2009. **28 (2010)**: p. 82–94.
- J.M. Guilemany, S. Dosta, and J.R. Miguel, *The enhancement of the properties* of WC-Co HVOF coatings through the use of nanostructured and microstructured feedstock powders. Surface & Coatings Technology 2006. 201 (2006): p. 1180–1190.
- D.H. Jeong, et al., The effect of grain size on the wear properties of electrodeposited nanocrystalline nickel coatings. Scripta mater., 2000. 44 (2001): p. 493–499.
- Amnuaysak Chianpairot, et al., Corrosion of nanocrystalline Ni–W alloys in alkaline and acidic 3.5 wt.% NaCl solutions. Corrosion Science 2010. 53 (2011): p. 1066–1071.
- K.R. Sriraman, S. Ganesh Sundara Raman, and S.K. Seshadri, *Synthesis and evaluation of hardness and sliding wear resistance of electrodeposited nanocrystalline Ni–W alloys.* Materials Science and Engineering A 2005 418 (2006): p. 303–311.

- C.A. Schuh, T.G. Nieh, and H. Iwasaki, *The effect of solid solution W additions* on the mechanical properties of nanocrystalline Ni. Acta Materialia 2002. 51 (2003): p. 431–443.
- Yamasaki, T., High-strength nanocrystalline Ni-W alloys produced by electrodeposition and their embrittlement behaviors during grain growth. Scripta mater., 2000. 44 (2001): p. 1497–1502.
- 14. S. Alirezaei, et al., *Wear behavior of Ni–P and Ni–P–Al2O3 electroless coatings.* Wear 2006. **262 (2007)**: p. 978–985.
- V.D. Papachristos, et al., Young's modulus, hardness and scratch adhesion of Ni–P–W multilayered alloy coatings produced by pulse plating. Thin Solid Films 2001. 396 (2001): p. 173–182.
- 16. C.N. Panagopoulos, et al., *Ni-P-W multilayered alloy coatings produced by pulse plating.* Scripta mater. , 2000. **43 (2000)**: p. 677–683.
- V.D. Papachristos, et al., Effect of annealing on the structure and hardness of Ni–P–W multilayered alloy coatings produced by pulse plating. Materials Science and Engineering, 1999. A279 (2000): p. 217–230.
- V.D. Papachristos, et al., *Sliding wear behaviour of Ni–P–W composition-modulated coatings*. Surface and Coatings Technology 1998. **105 (1998)**: p. 224–231.
- 19. J. Lamovec, et al., *Microhardness analysis of thin mettallic multilayer composite films on copper substrates.* Min. Metall., 2011. Sect. B-Metall. 47
  (1) B (2011): p. 53 61.
- สถิรจินดา, ม., โลหะนอกกลุ่มเหล็ก. 2543, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- Kenneth Holmberg and A. Matthews, Coatings Tribology Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering. Vol. 56.
   2009: TRIBOLOGY AND INTERFACE ENGINEERING SERIES.
- 22. ทองมอญ., อ., ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า. 2544, กรุงเทพมหานคร: สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุน.
- M.S. Chandrasekar and M. Pushpavanam, *Pulse and pulse reverse plating— Conceptual, advantages and applications.* Electrochimica Acta 2007.
   53(2008): p. 3313–3322.
- 24. Hansen, N., *Hall–Petch relation and boundary strengthening.* Scripta Materialia, 2004. **51**(8): p. 801-806.
- 25. Dini, J.W., *Electrodeposition The Materials Science of Coatings and Substrates*. 1993, Califorilia: NOYES.

- 26. Gwidon W. Stachowiak and A.W. Batchelor, *Engineering Tribology*. 3 ed. 2005: ELSEVIER
- 27. Milan Paunovic and M. Schlesinger, *Fundamentals Of Electrochemical Deposition*. 2 ed. 2006: A John Wiely & Sons.
- F. Hu and K.C. Chan, Deposition behaviour and morphology of Ni–SiC electrocomposites under triangular waveform. Applied Surface Science 2004. 243 (2005): p. 251–258.
- 29. Yi Kong and L. Shen, *Strengthening mechanism of metallic nanoscale multilayer with negative enthalpy of mixing.* J. Appl. Phys., 2011. **110**(073522 (2011)).
- 30. J. Wang and A. Misra, *An overview of interface-dominated deformation mechanisms in metallic multilayers.* Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2010. **15(2011)**: p. 20–28.
- 31. Detor Andrew J. and S.C. A., *Grain boundary segregation, chemical ordering and stability of nanocrystalline alloys: Atomistic computer simulations in the Ni–W system.* Acta Materialia, 2007. **55**(12): p. 4221-4232.
- 32. Andrew J. Detor and C.A. Schuh, *Tailoring and patterning the grain size of nanocrystalline alloys.* Acta Materialia 2006. **55 (2007)**: p. 371–379.
- 33. Watanabe, T., *Nano-plating: Microstructure Control Theory of Plated Film and Data Base of Plated Film Microstructure*. 1 ed. 2004.
- Misra A., Hirth J. P., and H.R. G., Length-scale-dependent deformation mechanisms in incoherent metallic multilayered composites. Acta Materialia, 2005. 53(18): p. 4817-4824.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University




ภาพที่ ผ. 1 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทังสเตน ชิ้นงาน A



ภาพที่ ผ. 2 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทังสเตน ชิ้นงาน B



ภาพที่ ผ. 3 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทังสเตน ชิ้นงาน C



ภาพที่ ผ. 4 X-ray diffraction ของวัสดุนิกเกิลทังสเตน ชิ้นงาน D

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ - นามสกุล นายณัฐดล อุดมปณิธ

วัน – เดือน – ปีเกิด 16 พฤษภาคม 2531

ที่อยู่ 2/58 ซอยลาดพร้าว17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

โทรศัพท์ติดต่อ 021400105



